

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民專訴字第53號

原告 ENTEGRIS, INC. (美國安堤格里斯公司)

法定代理人 Joseph Colella

訴訟代理人 張哲倫律師

陳初梅律師

陳佳菁律師

上 一 人

複 代 理 人 張恒睿律師

蕭詠翰專利師

被告 家登精密工業股份有限公司

兼法定代理人 邱銘乾

共 同

訴訟代理人 郭雨嵐律師

黃秀禎律師

蔡祁芳律師

汪家倩律師

李佶穎律師

上 一 人

複 代 理 人 吳雅貞律師

輔 佐 人 陳建銘

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國115年4月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律

(即準據法)，而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台字第2259號判決意旨參照）。查本件原告為依外國法設立之外國法人，具有涉外因素，為涉外民事事件；原告主張被告家登精密工業股份有限公司(下稱被告公司)在我國境內侵害其所有中華民國第I830642號「基板容器」發明專利（下稱系爭專利），則應定性為侵害專利權事件，應類推民事訴訟法第15條第1項規定，以侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產及商業法院有管轄權，智慧財產案件審理法第9條第1項、智慧財產法院組織法第3條第1款分別定有明文。是以，本院對本件涉外事件具有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定本件涉外事件之準據法。次按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告於本件主張其依我國專利法規定取得之專利權有遭侵害之虞，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。

二、再按公司法於民國107年8月1日修正、同年11月1日公布施行之第4條規定：「本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司。外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力。」即廢除外國公司認許制度，尊重依外國法設立之外國公司於其本國取得法人格之既存事實，而認與我國公司具有相同權利能力。又按有權利能力者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第1項定有明文。查原告為依外國法律設立之外國法人，與我國公司有同一之權利能力，即有當事人能力，自得為本件原告。

貳、實體部分：

一、原告主張：

原告係半導體與其他高科技產業供應商，為系爭專利之專利權人，專利權期間自113年1月21日至131年10月26日。詎原告發現被告公司製造販售之「300 Diffuser FOUP」產品(下

稱系爭產品)，與原告之Diffuser FOUP產品「A300」型號相似，經專利侵權比對分析後，認系爭產品已落入系爭專利更正後請求項15至18之文義範圍及均等範圍。通知被告公司未經原告同意或授權，仍繼續販售侵害系爭專利之系爭產品，顯屬故意侵害原告之系爭專利權，爰依專利法第96條第1至3項、民法第184條第1項前段之規定，請求被告公司排除侵害、銷毀，並負損害賠償責任；另被告邱銘乾為被告公司之負責人，爰依公司法第23條第2項，請求被告邱銘乾與被告公司連帶負賠償責任等語，並聲明：(一)被告等應連帶給付原告新臺幣(下同)3,000萬元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口型號為「300 Diffuser FOUP」或其他侵害系爭專利之「前開式晶圓傳送盒」之產品。(三)前項聲明之侵權產品，應予回收並銷毀。(四)訴訟費用由被告等連帶負擔。(五)就第一項、第二項之聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告等則以：

原告所提之系爭專利第一次及第二次更正依專利法第77條第3項規定視為撤回，又原告已於本院114年4月23日當庭表示不再更正系爭專利，然原告竟於114年8月4日向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)為第三次更正，就請求項15部分漏未引用專利說明書第0041段，應為實質變更系爭專利請求項15申請專利範圍，是該更正不應准許。又系爭專利說明書違反專利法第26條第1項，而系爭專利更正後請求項15不明確且未為說明書所支持，違反專利法第26條第2項規定。且乙證2或11足以證明更正後請求項15至17不具新穎性；乙證2足以證明更正後請求項18不具新穎性；乙證2、6、8、11擇一、乙證2、6之組合、乙證2、8之組合、乙證2、9之組合；乙證5、2之組合、乙證5、6之組合、乙證5、8之組合、乙證5、9之組合；乙證11、5之組合、乙證11、6之組合、乙證11、8之組合、乙證11、9之組合足以證明系爭專利更正後請求項1

5至18不具進步性，系爭專利有應撤銷事由，原告不得對被告主張專利權等語，資為抗辯。並答辯聲明：(一)原告之訴及假執行之聲請均駁回。(二)訴訟費用由原告負擔。(三)如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

參、兩造不爭執事項（本院卷六第219頁，並依本院論述與妥適調整文句）：

一、原告係系爭專利之專利權人，專利期間自113年1月21日至131年10月26日。

二、被告公司有製造並販售系爭產品。

三、被告邱銘乾為被告公司負責人。

四、原告於113年10月29日、114年4月22日、同年8月4日就系爭專利向智慧局申請更正，目前尚在審查中。

肆、兩造間主要爭點（本院卷六第220至221頁，並依本院論述與妥適調整文句）：

一、專利請求項更正事項部分：

(一)系爭專利說明書第[0029]段之更正，是否符合專利法第67條第1項第4款、2項之規定？

(二)系爭專利說明書第[0042]、[0078]、[0079]、[0082]段之更正，是否符合專利法第67條第1項第3款、2項之規定？

(三)系爭專利說明書第[0046]段之更正，是否符合專利法第67條第1項第4款、2項之規定？

(四)系爭專利請求項15、17、18之更正，是否符合專利法第67條第1項第2款、2、4項之規定？

二、專利解釋：

系爭專利更正後請求項15中之「歧管基底」、「流動路徑」、「組合且接著劃分」，應如何解釋？

三、專利侵權部分：

系爭產品是否落入系爭專利更正後請求項15至18之文義及均等範圍？

四、專利有效性部分：

(一)系爭專利說明書是否違反專利法第26條第1項規定？

01 (二)系爭專利更正後請求項15是否不明確，且未為說明書所支持
02 而違反專利法第26條第2項之規定？

03 (三)乙證2是否足以證明更正後請求項15至18不具新穎性？

04 (四)乙證11是否足以證明更正後請求項15至17不具新穎性？

05 (五)乙證2、6、8、11分別是否足以證明系爭專利更正後請求項1
06 5至18不具進步性？

07 (六)乙證2、6之組合、乙證2、8之組合、乙證2、9之組合，是否
08 足以證明系爭專利更正後請求項15至18不具進步性？

09 (七)乙證5、2之組合、乙證5、6之組合、乙證5、8之組合、乙證
10 5、9之組合，是否足以證明系爭專利更正後請求項15至18不
11 具進步性？

12 (八)乙證11、5之組合、乙證11、6之組合、乙證11、8之組合、
13 乙證11、9之組合，是否足以證明系爭專利更正後請求項15
14 至18不具進步性？

15 五、原告依專利法第96條第2項、民法第184條第1項前段、公司
16 法第23條第2項之規定，請求被告等連帶負損害賠償責任是
17 否有理由？如有，金額為何？

18 六、原告依專利法第96條第1、3項規定，請求排除侵害並銷毀系
19 爭產品，是否有理由？

20 伍、得心證之理由：

21 一、系爭專利說明書第〔0029〕段之更正，符合專利法第67條第
22 1項第4款、2項之規定：

23 (一)按當事人依第41條第1項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之
24 原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，
25 應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張；法院得
26 就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法
27 律上見解及適度開示心證，智慧財產案件審理法第43條第1
28 項、第4項分別定有明文。本件系爭專利請求項共18項，其
29 中請求項1、15為獨立項，餘為附屬項，原告就系爭專利請
30 求項1至3、7至13、15、17、18，於113年10月29日向智慧局
31 申請更正(下稱第一次更正)，刪除請求項10，請求項15、1

7、18更正依據為說明書第[0029]至[0031]、[0038]、[0039]、[0041]、[0046]、[0049]、[0050]、[0052]、[0053]、[0075]、[0081]段；復於114年4月22日向智慧局就系爭專利請求項1至3、7至13、15、17、18申請更正(下稱第二次更正)，請求項15至18更正依據為說明書第[0029]至[0031]、[0038]、[0039]、[0046]、[0049]、[0050]、[0052]、[0053]、[0075]、[0081]段，另將請求項2由附屬項改寫為獨立項；再於114年8月4日刪除請求項1至9、11至14，更正請求項15至18(下稱第三次更正)，更正依據為說明書第[0029]至[0031]、[0038]、[0039]、[0046]、[0049]、[0050]、[0052]、[0053]、[0075]、[0081]段，另陳明第三次更正僅為配合縮減主張範圍，僅以請求項15至18為請求而申請更正(本院卷六第117至118頁)，觀之上述說明書更正內容，僅為更正所引之理由為說明書不同段落，不影響將來解釋請求項時能依據之說明書內容，因該更正申請於本件審理期間尚未審定，被告復提出引證抗辯系爭專利有應撤銷事由，揆諸上開規定，本院自應審究上開系爭專利第三次更正後請求項之合法性，合先敘明。被告辯稱：原告於本院114年4月23日準備程序時表示就系爭專利請求項內容不會再為更正，然卻提出第三次更正之內容，顯然違背承諾，本院應不許原告第三次更正之內容云云，然原告前開第三次更正係為減縮其主張之請求項範圍，並更正所引之理由為說明書不同段落，就其主張之請求項內容並非實質更正，故被告所辯尚無足採。

(二)被告辯稱：第三次更正申請僅係於第二次更正基礎上，刪除請求項1-9、11-14，然就更正請求項15部分，第二、三次更正理由漏未記載說明書第[0041]段所載內容，即漏未說明原告係以系爭專利「圖3C」所示實施例，支持請求項15於更正時新增之下列技術特徵，將導致第二、三次更正在申請專利範圍之解釋不同於第一次更正理由之涵義；又系爭專利更正後請求項15超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍，且實質變更公告時申請專利範圍，違反專利法第67條

第2項及第4項規定；更正後請求項16、17、18違反專利法第67條第2項及第4項規定；更正後說明書[0029]段超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反專利法第67條第2項規定云云(本院卷六第31、第412至426頁)。然查：

- 1.依專利審查基準第二篇第一章第2-1-34頁關於「請求項之解釋」之原則，解釋請求項應以其明確記載之文義為準，並參酌說明書及圖式之整體內容。原告於第二、三次更正理由中未列出說明書第[0041]段之文字，然該段落及對應之「圖3C」內容始終存在於原說明書中，客觀上自能用於解釋請求項15之申請專利範圍，況專利審查基準中並無「請求項之解釋應受更正理由記載內容限制」之規範，故請求項15經准予更正，其範圍仍應依更正後之請求項文義，並結合說明書揭露之技術內容進行客觀解釋，不受原告在申請更正專利請求項內容行政程序中釋明理由之簡繁，而對其明確之文義產生不當之拘束。是被告主張第二、三次更正因漏載部分說明而導致請求項解釋發生變動，顯屬無據。
- 2.經查系爭專利說明書第[0029]、[0046]段揭露基板容器可在底壁上包含「複數個入口清洗埠」，並具體編號如30A、30B、30C或430A、430B。又系爭專利說明書第[0050]段揭露「歧管基底560包含連接至入口清洗埠……之第一流動路徑560A以及連接至入口清洗埠……之一第二流動路徑560B」，由於第一路徑560A供應給後方裝置550A、550B，而第二路徑560B供應給前方裝置550C至550E，故在結構配置上，該些路徑自當分別接入底壁上不同位置的入口清洗埠，以實現分流效果。再者，系爭專利說明書中曾多次使用「附接」來描述不同元件間的物理結合或安裝關係，例如說明書第[0045]段揭露「……一載板423，其可提供殼體406可被附接之一基底」，說明書第[0048]段揭露「……基板容器500亦可包含一載板523，其可提供殼體506可被附接之一基底」，考量在系爭專利說明書圖4A實施例中載板423與殼體406之間並無其

01 他元件存在，為直接接觸，而另一實施例(圖5)中載板523與
02 殼體506之間係透過歧管基底560連接，可知在系爭專利說明
03 書中，「附接」主要係描述元件間之連通狀態，但並未被定
04 義為必須是「無中間媒介的直接接觸」，同理，系爭專利更
05 正後請求項15所新增之「一歧管基底，其設置於該殼體之外
06 部並附接於該底壁上之該複數個入口清洗埠……」之技術特
07 徵完全符合系爭專利圖5A、5B實施例中歧管基底560作為流
08 體分配中樞，與底壁複數個入口清洗埠連通之技術本質。綜
09 上所述，更正後請求項15僅係進一步界定歧管基底與入口清
10 洗埠之配置關係，屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時說
11 明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

12 3.經查系爭專利圖式第4A、4B圖及第5A圖中，關於氣體分配裝
13 置之擴散器（如元件450A、450B或550A、550B）之形狀均有
14 明確揭露。觀察圖4A所示之實施例，後氣體分配裝置450A、
15 450B係呈現為縱向延伸之長條形結構；配合圖4B之側視截面
16 圖觀之，該擴散器內部具備氣流通道，且其外觀輪廓顯屬管
17 狀形態。又系爭專利說明書第[0018]段對於「供應管線」及
18 「導管」等術語之定義，已明確涵蓋「管道、配管、管件」
19 等結構。由於擴散器本身即為清洗流體分配系統中負責引導
20 並分配氣流之結構組件，實施上必然與系統中之管道或配管
21 相結合。此種具備內部流道、連接開口且呈縱向延伸之結構
22 特徵，與一般技術領域所認知之「管狀」構造完全吻合。可
23 知依圖式4A、4B及5A所揭露之具體形狀特徵進行描述性之限
24 定，將更正後請求項15「擴散器」進一步界定為「管狀擴散
25 器」，屬申請專利範圍之減縮，且並未超出申請時說明書、
26 申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

27 4.系爭專利說明書第[0040]段記載：「入口包含至少兩個入口
28 埠305A及305B……」，是以將「一入口」更正為「複數個入
29 口埠」，係使請求項之文字與說明書所揭露之具體實施結構
30 趨於一致，並未實質變更公告時之申請專利範圍，故更正後
31 請求項15將「一入口」更正為「複數個入口埠」，並未實質

變更公告時之申請專利範圍。更正後請求項17、18依附於請求項15，更正後請求項15並未違反專利法第67條第2項及第4項規定之理由，已如前述，則更正後請求項 17、18亦無違反前開規定之情事。又依系爭專利說明書第[0029]段及圖2揭露，入口清洗埠30A、30B、30C係設置於殼體6之底壁22上，而該底壁與殼體之其他壁面共同界定出內部空間8。參酌說明書第[0031]段，清洗流體分配系統之核心功能在於「將清洗氣體供應至入口清洗埠以將清洗氣體分配至內部空間8中」，且該氣流經組態後係自內部空間8流出以阻絕外部污染。依半導體設備之技術本質與物理常理觀之，若入口清洗埠不具備朝向內部空間之開口，則清洗氣體根本無法達成說明書所載「分配至內部空間」之唯一技術目的，被告將圖2中明確繪製於內部空間範圍內之清洗埠結構強解為「封閉且無方向」之線條(參本院卷六第424至425頁)，實屬無視發明目的之曲解，是更正後說明書[0029]段未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故被告前開所辯均無足採。

(三)按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得不明瞭記載之釋明為之；更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，專利法第67條第1項第4款、第2項分別定有明文。次按「所謂不明瞭記載，指公告專利之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者」發明專利審查基準(113年7月1日施行版)第二篇第九章第2-9-4頁定有明文。

(四)原告主張說明書第[0029]段之更正係依據專利法第67條第1項第4款「不明瞭記載之釋明」為之；該更正處係將圖式2所

01 記載「複數個入口清洗埠各自朝向基板容器之內部空間8有
02 一開口」之圖案特徵新增至該段說明書等語(參本院卷六第7
03 2頁)。經查，圖式2確實記載「入口清洗埠及/或出口清洗埠
04 30A、30B、30C是對內部空間8開放」，故必然存在一開口與
05 之連接，說明書第[0029]段之更正，係更充分說明圖式2所
06 記載之內容避免不明確，該發明所屬技術領域中具有通常知
07 識者自圖式2所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，故應
08 准予對該不明瞭之記載所為之釋明，符合專利法第67條第1
09 項第4款之規定。且系爭專利說明書[0029]段之更正，源自
10 圖式2已記載之內容，並未超出申請時說明書、申請專利範
11 圍或圖式所揭露之範圍，符合專利法第67條第2項之規定。

12 (五)被告雖辯稱：更正後說明書[0029]段超出申請時說明書、申
13 請專利範圍或圖式所揭露之範圍云云，然依系爭專利說明書
14 第[0029]段及圖2揭露，入口清洗埠30A、30B、30C係設置於
15 殼體6之底壁22上，而該底壁與殼體之其他壁面共同界定出
16 內部空間8。又參酌說明書第[0031]段，清洗流體分配系統
17 之核心功能即在於「將清洗氣體供應至入口清洗埠以將清洗
18 氣體分配至內部空間8中」(參本院卷一第83頁)，且該氣流
19 經組態後係自內部空間8流出以阻絕外部污染。依半導體設
20 備之技術本質與物理常理觀之，若入口清洗埠不具備朝向內
21 部空間之開口，則清洗氣體根本無法達成說明書所載「分配
22 至內部空間」之唯一技術目的，被告將圖2中明確繪製於內
23 部空間範圍內之清洗埠結構強解為「封閉且無方向」之線條
24 (參本院卷六第424至425頁)，實屬無視發明目的之曲解，故
25 被告所辯顯無足採。

26 二、系爭專利說明書第〔0042〕、〔0078〕、〔0079〕、〔008
27 2〕段之更正，符合專利法第67條第1項第3款、2項之規定：

28 (一)按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖
29 式，僅得就誤記或誤譯之訂正事項為之；更正，除誤譯之訂
30 正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露
31 之範圍，專利法第67條第1項第3款、第2項分別定有明文。

01 次按「所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知
02 識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部檔即可直接由
03 說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察
04 覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何
05 訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖
06 式已實質揭露，於解讀時不致影響原來實質內容者」發明專
07 利審查基準(113年7月1日施行版)第二篇第九章第2-9-2頁定
08 有明文。

09 (二)原告主張依專利法第67條第1項第3款「誤記或誤譯之訂正」
10 之規定，將說明書第[0042]、[0078]、[0079]、[0082]段
11 「入口埠」變更為「入口清洗埠」等語(本院卷六第72至76
12 頁)。查本案公告說明書段落[0042]第7至12行記載「入口
13 埠」可為基板容器之底壁上之「後入口埠」或「第二入口
14 埠」。然而，本案公告之說明書段落[0029]第1至2行、說明
15 書段落[0046]第5至6行、段落[0049]第5至6行、段落[0075]
16 內容皆清楚描述在基板容器之底壁上之「埠」所對應之名稱
17 應為「入口清洗埠」而非「入口埠」，故應准予對該誤記處
18 所為之訂正，自符合專利法第67條第1項第3款之規定。又系
19 爭專利說明書[0042]、[0078]、[0079]、[0082]段之更正源
20 自說明書其他段落已記載之內容，並未超出申請時說明書、
21 申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自符合專利法第67條第
22 2項之規定。

23 三、系爭專利說明書第〔0046〕段之更正，符合專利法第67條第
24 1項第4款、2項之規定：

25 原告主張說明書第[0046]段之更正係依專利法第67條第1項
26 第4款「不明瞭記載之釋明」為之，係新增圖式4A所記載
27 「管狀擴散器」之圖案特徵等語(參本院卷六第74頁)。經
28 查，圖式4A記載之擴散器確呈管狀，說明書第[0046]段之更
29 正係將圖式4A所記載之內容更充分說明以避免不明確，該發
30 明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式4A所記載之內容能
31 明顯瞭解其固有的涵義，故應准予對該不明瞭之記載所為之

01 釋明，符合專利法第67條第1項第4款之規定。又系爭專利說
02 明書第[0046]段之更正係源自圖式4A已記載之內容，未超出
03 申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，符合專
04 利法第67條第2項之規定。

05 四、系爭專利更正後請求項15、17、18之更正，符合專利法第67
06 條第1項第2款、2、4項之規定：

07 (一)系爭專利更正後請求項15之更正，符合專利法第67條第1項
08 第2款、2、4項之規定：

09 1.按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖
10 式，僅得就申請專利範圍之減縮事項為之；更正，除誤譯之
11 訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭
12 露之範圍；更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範
13 圍，專利法第67條第1項第2款、第2項、第4項分別定有明
14 文。

15 2.原告主張依專利法第67條第1項第2款「申請專利範圍之減
16 縮」之規定更正請求項15，新增「其中複數個入口清洗埠被
17 提供於該殼體之該底壁上」、「一歧管基底，其設置於該殼
18 體之外部並附接於該底壁上之該複數個入口清洗埠」、「且
19 該歧管基底包含連接至該複數個入口埠之一流動路徑」、「
20 「複數個管狀擴散器，其經由該複數個入口清洗埠與該歧管
21 基底連通」、「其中，該歧管基底之該流動路徑將來自該複
22 數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分，將該清洗氣體
23 流供應至該複數個管狀擴散器」之技術特徵，並另將「一入
24 口」變更為「複數個入口埠」等語(參本院卷六第77至79
25 頁)。經查，更正後請求項15更正處係進一步限定基板容器
26 與歧管基底相互位置關係與連結關係之具體構造，屬於申請
27 專利範圍之減縮，符合專利法第67條第1項第2款之規定。又
28 請求項15之更正係源自更正後說明書第[0029]、[0046]至[0
29 050]、[0075]段已揭露之技術特徵，並未超出申請時說明
30 書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，符合專利法第67條
31 第2項之規定。前開更正處並未變更申請標的，亦未影響系

01 爭專利「藉由將來自一共同輸入埠之清洗氣體流劃分給複數
02 個離散輸入清洗埠來將清洗氣體流分配至基板容器之內部空
03 間中用於供應分開之氣體分配裝置之一網路」之發明目的，
04 是以前開更正均未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，
05 符合專利法第67條第4項之規定。

06 (二)系爭專利更正後請求項17之更正，符合專利法第67條第1項
07 第2款、2、4項之規定：

08 原告主張請求項17之更正係依專利法第67條第1項第2款「申
09 請專利範圍之減縮」，為適應請求項15更正內容，將「該至
10 少一擴散器」變更為「該複數個管狀擴散器之一者」等語
11 (參本院卷六第79頁)。經查，請求項17進一步限定擴散器數
12 量以及其構造，符合專利法第67條第1項第2款申請專利範圍
13 之減縮之規定。又請求項17之更正係源自更正後說明書第[0
14 046]段已揭露之技術特徵，並未超出申請時說明書、申請專
15 利範圍或圖式所揭露之範圍，符合專利法第67條第2項之規
16 定。前開更正處並未變更申請標的，亦未影響系爭專利「藉
17 由將來自一共同輸入埠之清洗氣體流劃分給複數個離散輸入
18 清洗埠來將清洗氣體流分配至基板容器之內部空間中用於供
19 應分開之氣體分配裝置之一網路」之發明目的，是以前開更
20 正均未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法
21 第67條第4項之規定。

22 (三)系爭專利更正後請求項18之更正，符合專利法第67條第1項
23 第2款、2、4項之規定：

24 原告主張依專利法第67條第1項第2款「申請專利範圍之減
25 縮」更正請求項18，為適應請求項15更正內容，將「該擴散
26 器」變更為「該複數個管狀擴散器」等語(參本院卷六第80
27 頁)。經查，請求項18進一步限定擴散器數量以及其構造，
28 符合專利法第67條第1項第2款申請專利範圍之減縮之規定。
29 又請求項18之更正係源自更正後說明書第[0046]段已揭露之
30 技術特徵，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所
31 揭露之範圍，符合專利法第67條第2項之規定。前開更正處

並未變更申請標的，亦未影響系爭專利「藉由將來自一共同輸入埠之清洗氣體流劃分給複數個離散輸入清洗埠來將清洗氣體流分配至基板容器之內部空間中用於供應分開之氣體分配裝置之一網路」之發明目的，是以前開更正均未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第4項之規定。

五、系爭專利更正後請求項15中之「歧管基底」、「流動路徑」、「組合且接著劃分」之解釋：

(一)系爭專利更正後請求項15中之「歧管基底」之解釋：

系爭專利說明書第【0005】段揭露「……該清洗流體分配系統進一步包含提供於該底壁上之一歧管基底，該歧管基底接收來自該入口之該清洗氣體流以將該清洗氣體流劃分給氣體分配裝置之該網路，其中該歧管基底可經組態以將該第二流動路徑劃分給至少一左側第二流動路徑及一右側第二流動路徑……」（本院卷一第69、71頁）；說明書第【0049】段揭露「……清洗流體分配系統540包含提供於底壁522上之一歧管基底560，歧管基底560經組態以將清洗氣體流劃分給氣體分配裝置之網路」（本院卷一第97、99頁）；說明書第【0050】段揭露「……歧管基底560連接至分開之氣體分配裝置550之網路。歧管基底560包含連接至入口清洗埠用於向一第一氣體分配裝置供應清洗氣體之一第一流動路徑560A及連接至入口清洗埠用於向一第二氣體分配裝置供應清洗氣體之一第二流動路徑560B」（本院卷一第99頁）；說明書第【0052】段揭露「……歧管基底560可用於藉由設置可調閥580、585A、585B、585C、585D來將來自供應管線之清洗氣體劃分給分開之氣體分配裝置之網路及/或分開之氣體分配表面」（本院卷一第99、101頁）。綜上，系爭專利說明書針對「歧管基底」已有明確揭露之定義與功能描述，即「歧管基底」係設置於氣體流體分配系統底壁外表面，具有入口用以接收清洗氣體流，並經組態以透過內部之複數個流動路徑，將接收之清洗氣體流劃分並供應予氣體分配裝置（如擴散器、歧管）之網

01 路或氣體分配表面，故應考量系爭專利說明書中之定義或說
02 明，將「歧管基底」解釋為「設置於氣體流體分配系統底壁
03 之外側表面，用以接收清洗流體並將其劃分供應至複數個氣
04 體分配裝置之基底結構」。

05 (二)系爭專利更正後請求項15中之「流動路徑」之解釋：

06 系爭專利說明書第【0005】段揭露「……該供應管線包含通
07 向分開之氣體分配裝置之該網路之一者之一第一流動路徑及
08 通向分開之氣體分配裝置之該網路之另一者之一第二流動路
09 徑」（本院卷一第69、71頁）；說明書第【0033】段揭露
10 「……供應管線包含連接至一第一氣體分配裝置350A之至少
11 一第一流動路徑360A及連接至一第二氣體分配裝置350B之至
12 少一第二流動路徑360B」（本院卷一第83頁）；說明書第【00
13 47】段揭露「……第二流動路徑460B包含沿較靠近基板容器
14 400之頂壁420之一頂部部分提供之一配管、通道或路
15 徑……」（本院卷一第95頁）；說明書第【0050】段揭露
16 「……歧管基底560包含連接至入口清洗埠用於向一第一氣
17 體分配裝置供應清洗氣體之一第一流動路徑560A及連接至入
18 口清洗埠用於向一第二氣體分配裝置供應清洗氣體之一第二
19 流動路徑560B」（本院卷一第99頁）；說明書第【0054】段揭
20 露「……第一流動路徑及／或第二流動路徑之各種管道之橫
21 截面積可經定大小以設置……劃分之清洗氣體量」（本院卷
22 一第101、103頁）。系爭專利說明書針對「流動路徑」已有
23 明確揭露其構造與功能，即「流動路徑」係指設置於供應管
24 線或歧管基底內部，用以連接入口埠與氣體分配裝置（如擴
25 散器、歧管）之配管、通道、管道或路徑構造，且可藉由調
26 整其橫截面積、設置孔口或閥門等結構，以控制清洗氣體之
27 供應量並將其引導至特定之分配位置，故應考量系爭專利說
28 明書之內容，應將「流動路徑」解釋為「用以導引清洗氣體
29 之通道」。

30 (三)系爭專利更正後請求項15中之「組合且接著劃分」之解釋：

01 系爭專利說明書第[0038]段揭露「……在此實施例中，供應
02 管線360連接至兩個入口埠305A及305B，使得清洗氣體之供
03 應經組合且接著劃分給連接至一第一氣體分配裝置350A之至
04 少一第一流動路徑360A及連接至一第二氣體分配裝置350B之
05 一第二流動路徑360B」（本院卷一第89頁）；說明書第[0081]
06 段亦記載「……該清洗流體分配系統之該入口包括一第一入
07 口及一第二入口，其中該供應管線經組態以將來自該第一入
08 口及該第二入口之該清洗氣體流組合且接著將該清洗氣體流
09 劃分給分開之氣體分配裝置之該網路」（本院卷一第113
10 頁）。系爭專利說明書針對清洗氣體之流動程序已有明確揭
11 露，即當基板容器設有複數個入口來源時，將來自該等不同
12 入口埠之清洗體流體匯集，以組合成一清洗流體源，隨後，
13 再依據預先設置之流向，將前開經匯集之清洗流體分流至複
14 數流動路徑，供應至基板容器內部空間，故應考量說明書之
15 定義與實施方式說明，應將「組合且接著劃分」解釋為「將
16 來自不同入口埠之清洗體流體匯集成一清洗流體源，隨後該
17 清洗流體源經複數流動路徑分流至基板容器中」。

18 六、系爭專利之技術分析：

19 (一)系爭專利之技術內容：

20 1.系爭專利所欲解決問題：

21 習知基板容器停靠在一負載埠上，且EFEM之門打開。接下
22 來，門自基板容器脫離，其容許容置在EFEM內之傳送單元接
23 達容納在基板容器內之基板用於處理。由風扇過濾器單元引
24 入之一氣流在自EFEM之一頂部至EFEM之一底部之一方向上流
25 過EFEM。當基板容器之前開口與EFEM之負載埠開口介接時，
26 流過EFEM並穿過負載埠開口之一些氣體可無意經引入容器之
27 內部中，從而藉由暫時引起基板容器之微環境內相對濕度
28 及/或氧氣位準之一增加而潛在地干擾基板容器之清洗能
29 力，其可為不期望的（參系爭專利說明書第[0003]段，本院
30 卷一第67至69頁）。

31 2.系爭專利之技術手段：

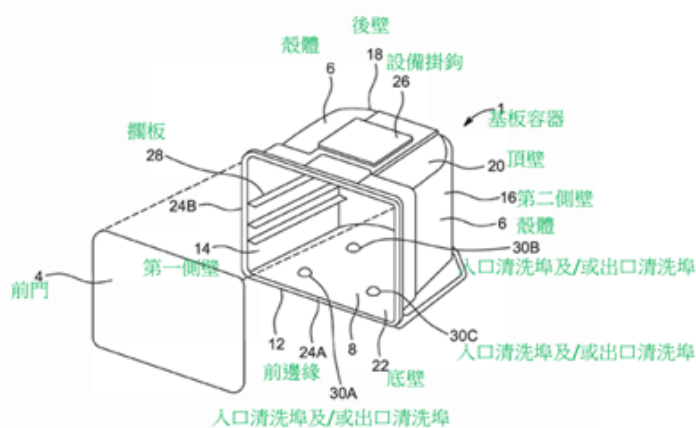
一基板容器包含界定一內部空間之一殼體，其中該殼體包含一前開口、一第一側壁、一第二側壁、一後壁及一底壁，該底壁包含沿該殼體之該前開口在該第一側壁與該第二側壁之間延伸之一前邊緣。該基板容器亦包含經組態以接收一清洗氣體流之一清洗流體分配系統，其中該清洗流體分配系統包含經組態以接收該清洗氣體流之一入口及經組態以將該清洗氣體流分配至該內部空間中之分開之氣體分配裝置之一網路。該清洗流體分配系統進一步包含連接至該入口之一供應管線，該供應管線經組態以將該清洗氣體流劃分給分開之氣體分配裝置之該網路。根據至少一個實例實施例，該供應管線包含通向分開之氣體分配裝置之該網路之一者之一第一流動路徑及通向分開之氣體分配裝置之該網路之另一者之一第二流動路徑。在一實施例中，氣體分配裝置之該網路之一者係提供於更靠近該後壁之一第一氣體分配裝置且氣體分配裝置之該網路之該另一者係一第二氣體分配裝置，其中該第二氣體分配裝置可提供於更靠近該前開口，且其中該第一流動路徑經組態以向該第一氣體分配裝置供應該清洗氣體流之一部分且該第二流動路徑經組態以向該第二氣體分配裝置供應該清洗氣體流之另一部分。應瞭解，該第二氣體分配裝置亦可提供於該基板容器之內部內之其他位置處，例如，提供於另一氣體分配裝置之後面或附近，且不限於上述實施例。根據至少一個其他實例實施例，該清洗流體分配系統進一步包含提供於該底壁上之一歧管基底，該歧管基底接收來自該入口之該清洗氣體流以將該清洗氣體流劃分給氣體分配裝置之該網路，其中該歧管基底可經組態以將該第二流動路徑劃分給至少一左側第二流動路徑及一右側第二流動路徑以將該清洗氣體流之該部分供應至該第二氣體分配裝置(參系爭專利說明書第[0005]段，本院卷一第69至71頁)。

3.系爭專利之功效：

清洗流體分配系統可經組態以在打開時防止氣體進入基板容器之前開口或當基板容器關閉時作為一出口以促進清洗氣體

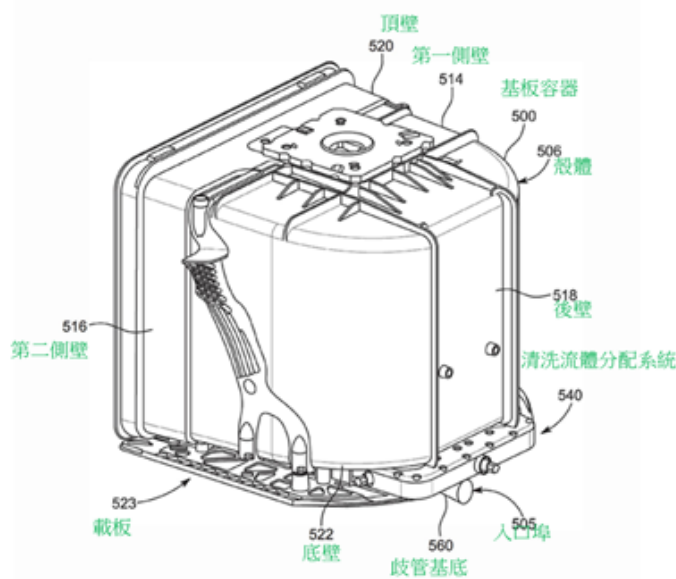
自基板容器排出。可處理呈晶圓形式之基板以形成半導體裝置。一基板容器係用於在處理期間承載基板之一容器。在不同處理步驟之前及期間，基板可儲存於一基板容器內。透過基板容器之一前開口接達基板容器。基板容器可為(例如)一前開式晶圓傳送盒(FOUP)(參系爭專利說明書第[0022]至[0023]段，本院卷一第77至79頁)。

(二)系爭專利主要圖式：



【圖2】

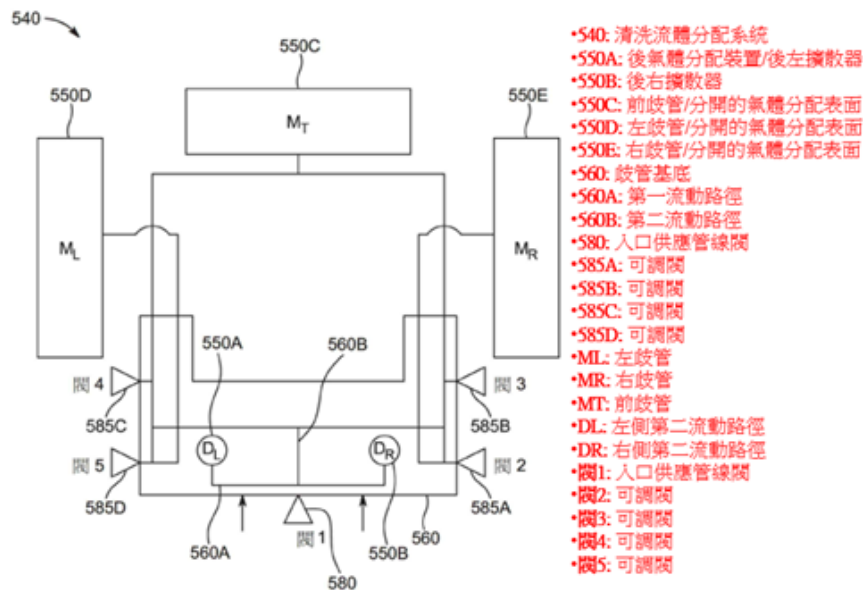
系爭專利圖式2為根據至少一個實例實施例之一基板容器之一分解圖式。



【圖5A】

系爭專利圖式5A為根據至少一個實例實施例之具有經組態以使

用一歧管基底來劃分清洗氣體之供應之一清洗流體分配系統之一基板容器之一後視立體圖式。



【圖5B】

系爭專利圖式5B顯示歧管基底560如何將清洗氣體流體劃分給分開的氣體分配裝置550網路。歧管基底560具有連接到入口清洗埠的第一流動路徑560A，用於將清洗氣體供應到第一（後）氣體分配裝置550A、550B，和連接到入口清洗埠的第二流動路徑560B，用於將清洗氣體供應到第二（前）氣體分配裝置550C、550D、550E。清洗氣體量可以透過調整閥門580、585A、585B、585C、585D來控制，這些閥門分別控制流向不同的氣體分配裝置和表面的流量，說明清洗氣體如何被分配到基板容器內的不同區域以進行有效清潔。

(三)系爭專利申請專利範圍：

系爭專利請求項共4項，其中請求項15為獨立項，餘為附屬項，原告前開申請更正請求項之範圍經本院認定更正合法，業如前述，其主張受侵害者為系爭專利更正後請求項15至18（以下不再稱更正後，逕以請求項稱之），內容如下：

- 1.請求項15：一種基板容器，其包括：一殼體，其界定一內部空間，該殼體包含一前開口、一第一側壁、一第二側壁、一後壁及一底壁，該底壁包含沿該殼體之該前開口在該第一側

壁與該第二側壁之間延伸之一前邊緣，其中複數個入口清洗埠被提供於該殼體之該底壁上；一歧管基底，其設置於該殼體之外部並附接於該底壁上之該複數個入口清洗埠，其中該歧管基底具有經組態以接收一清洗氣體流之複數個入口埠，且該歧管基底包含連接至該複數個入口埠之一流動路徑；及複數個管狀擴散器，其經由該複數個入口清洗埠與該歧管基底連通，以用於將該清洗氣體流分配至該殼體之該內部空間中，其中，該歧管基底之該流動路徑將來自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分，並經由該複數個入口清洗埠將該清洗氣體流供應至該複數個管狀擴散器。

2.請求項16：如請求項15之基板容器，其中該歧管基底設置於該殼體與一載板之間。

3.請求項17：如請求項15之基板容器，其中該複數個管狀擴散器之一者經設置為較靠近該殼體之該後壁。

4.請求項18：如請求項15之基板容器，其中該複數個管狀擴散器包括具有多孔材料之一氣體分配表面。

七、系爭產品技術內容：

(一)原告主張侵害系爭專利之系爭產品為被告公司所銷售之型號為「300 Diffuser FOUN」之產品，系爭產品300 diffuser FOUN係Front Opening Unified Pod的縮寫，其中300係指300mm，即12吋晶圓之公制尺寸；Diffuser係指氣體擴散器，將輸入的清洗氣體（通常是高純度氮氣）透過具備微小孔洞或多孔材質的管狀/板狀構造進行物理性的「擴散」，能讓氣流以低流速、大面積、均勻且穩定的方式進入晶圓儲存容器之內部空間；Front Opening指容器的門設計在正前方，方便自動化物料搬運系統或設備的裝載埠進行自動開啟與晶圓取放；Unified Pod意指符合 SEMI（國際半導體產業協會）的標準規格的晶圓容器，確保不同廠牌的生產設備與搬運系統都能通用，故整體而言，系爭產品300 diffuser FOUN之中文意義為「為12吋(300mm)晶圓設計，且配備有擴散器（Diffuser）進氣系統的前開式容器」，主要功能在半導

01 2.系爭產品底面詳細構造圖：

02 下圖詳盡呈現系爭產品底面之細部構造，包含○○○○○○○
03 ○之空間配置，並明確標示出○○○○○○○○○○○○○○○
04 ○，同時以箭頭輔助說明○○○○○○○○○○○○○○○
05 ○，藉此展現○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
06 ○○○○○○○○○○○○○○，完整揭露了系爭產品在氣體傳輸
07 與分配上之具體技術特徵(參本院限閱卷一第109頁)。

08 3.系爭產品之擴散器構造圖：

09 下圖呈現系爭產品內部之擴散器構造，透過正面視圖可見○
10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○並以紅
11 框與箭頭明確標示其具體形狀與裝設方位，藉此展示○○○
12 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
13 完整揭示了系爭產品內部關鍵之氣體擴散組件及其空間布局
14 (參本院限閱卷一第85頁)。

15 4.系爭產品安裝底部載板之構造圖：

16 下圖展示系爭產品之底部載板安裝完成後之具體構造，畫面
17 中明確標示出○○○○○之相對位置，並以紅色虛線框與箭
18 頭特別指明○○○○○之所在，藉此呈現○○○○○○○○○○
19 ○○○○○○○○○○○，完整揭露了○○○○○○○○○在產品底
20 部之裝配關係及其空間布局(參本院限閱卷一第82頁)。

21 5.系爭產品清洗氣體流向測試圖：

22 下圖呈現系爭產品進行清洗氣體流向測試之實際情形，照片
23 中顯示○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
24 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
25 ○○，此一測試結果直觀地證實了系爭產品內部導流構造對
26 氣體分布之作用，完整揭露清洗氣體進入基板容器內部後之
27 實際流場分布與運作狀態(參本院限閱卷一第183頁)。

八、有效性證據技術分析：

(一)乙證2：

1.技術內容：

乙證2揭露一種晶圓儲存容器(100)包含界定一內部空間(110)之一殼體、設置於該殼體底部之一氣體供應部(130)及複數個氣體供應噴嘴(150a-150f)。該氣體供應部(130)具有經組態以接收一氣體流之一氣體入口(135)。該等分開之氣體供應噴嘴(150a-150f)經組態以將該氣體流分配至該內部空間(110)中。更明確地，乙證2揭露一種晶圓儲存容器(100)內之氣體供應部(130)，用於藉由將來自一共同氣體入口(135)之氣體流劃分給複數個離散之分支路徑(131、132、133)來將氣體流分配至儲存容器(100)之內部空間(110)中，以供應至各個氣體分配裝置(150a-150f)。

2.主要圖式：

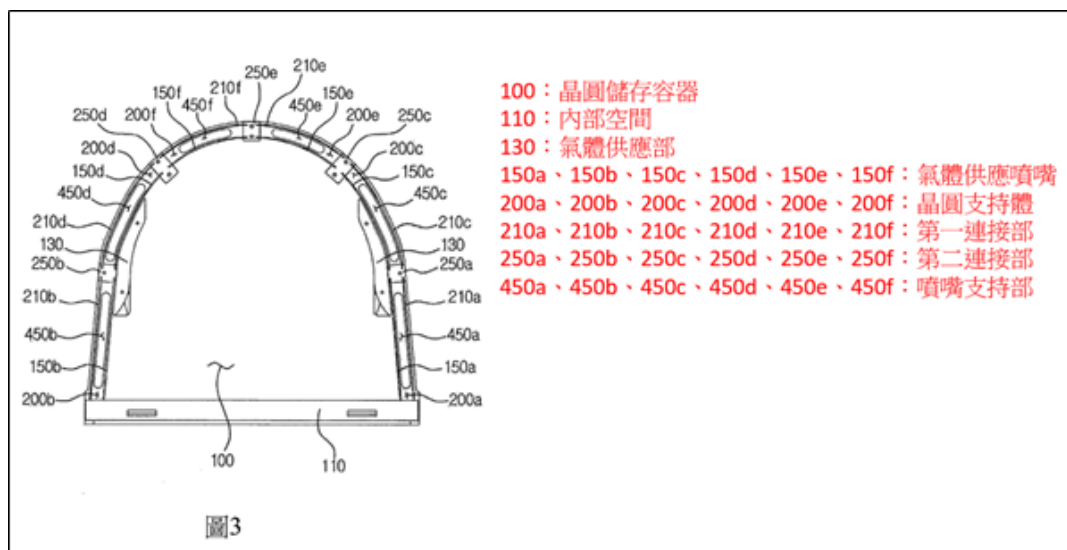
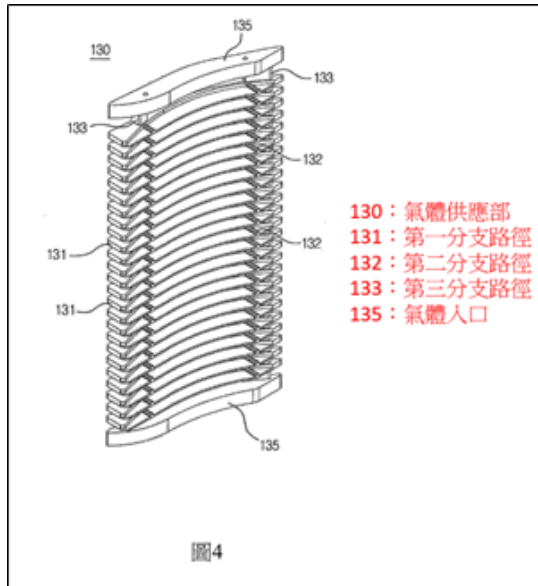
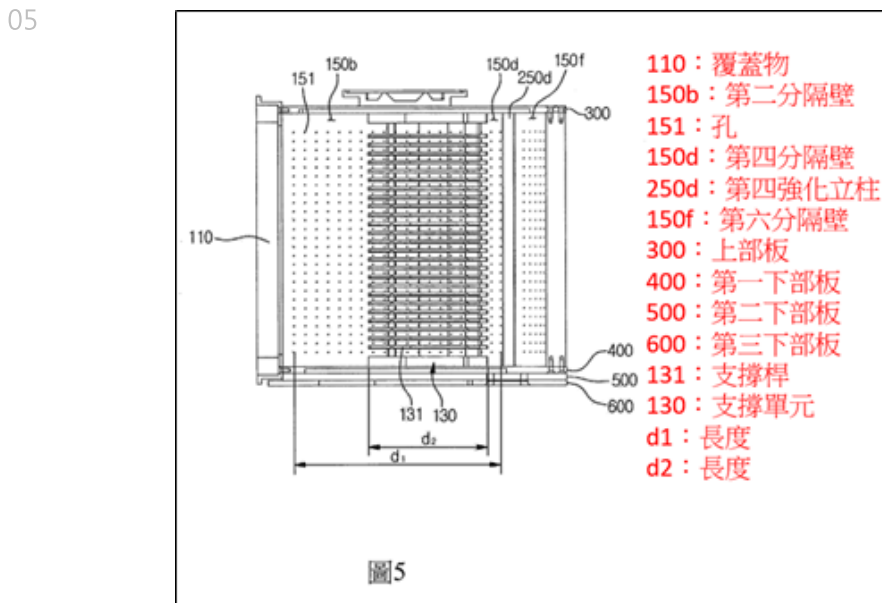


圖3係用於展示晶圓儲存容器(100)的整體結構，以及氣體供應噴嘴(150a-150f)在內部空間(110)中的分布位置。

01



02 圖4係展示氣體供應部（130）的內部構造，包含共同氣體入口（135）以及將氣體流劃分至不同分支路徑（131、132、133）的結構。



06 圖5係展示氣體流路與噴嘴（150b、150d、150f）之間的連
07 通關係，並說明氣體如何分配至內部空間。

08 (二)乙證5：

09 1.技術內容：

10 乙證5揭露一種可在不同處理設備之間移動的基板容器(30)
11 包含界定一微環境(64)之一殼體、設置於該殼體上之一歧管
12 基底(400)及二擴散器(70，402)。該殼體包含一前開口(4
13 8)、一底板(40)、相對側部(34)及一背部(42)。該歧管基底

(400)具有經組態以接收一清洗氣體流之一入口埠(408，437)。該等分開之擴散器(70，402)經組態以將該清洗氣體流分配至該微環境(64)中。更明確地，乙證5揭露一種一前開式晶圓容器(FOUP)內之歧管基底(400)，用於藉由將來自一共同入口埠(408，437)之吹洗氣體流劃分給複數個離散輸入清洗埠(386a，386b，386c)來將吹清氣體流分配至基板容器(30)之微環境(64)中用於供應至氣體分配裝置(382a，382b，382c)。

2.主要圖式：

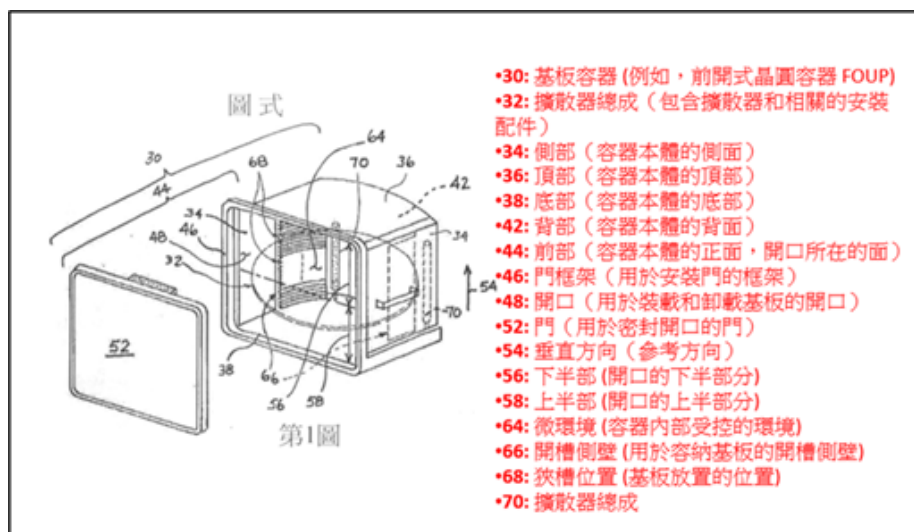


圖1係一基板容器之立體圖，其中展示了基板容器包含側部、頂部、底部、背部、前部、門框架、開口和門，以及基板容器內部的開槽側壁和擴散器總成。

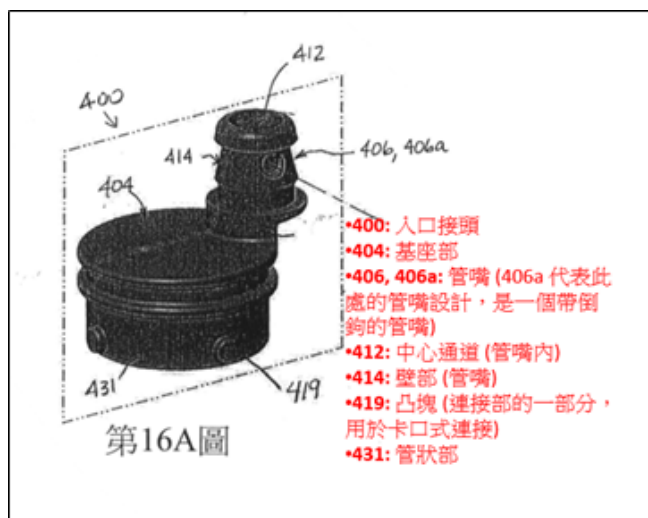


圖16A係一入口接頭之立體圖，其中展示了入口接頭的基座部、管嘴、凸塊和下插口。

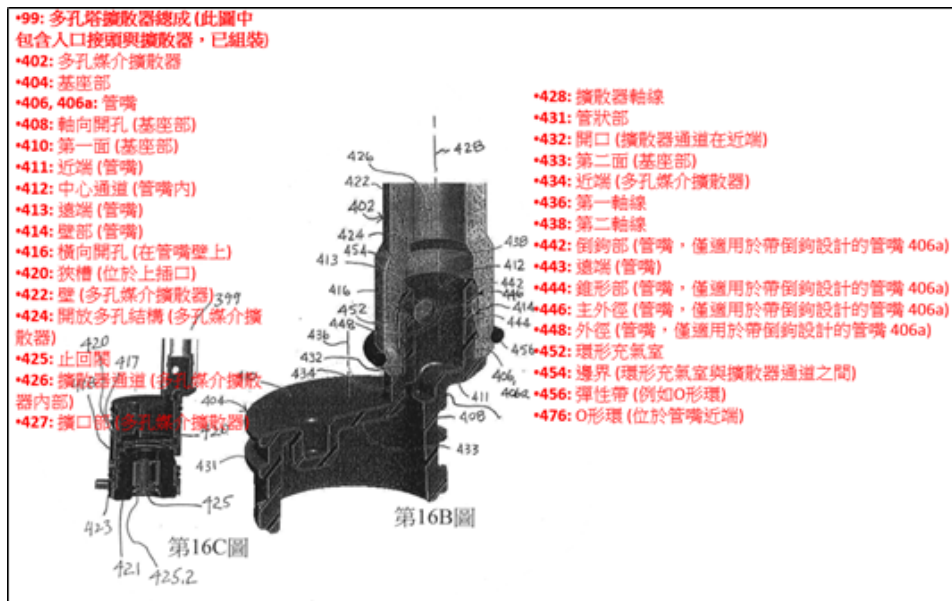


圖16B係一圖16A之入口接頭之剖視圖，其中展示了入口接頭的基座部、管嘴、橫向開孔、壁部、中心通道、多孔媒介擴散器、擴散器通道、擴口部、O形環和管狀部。

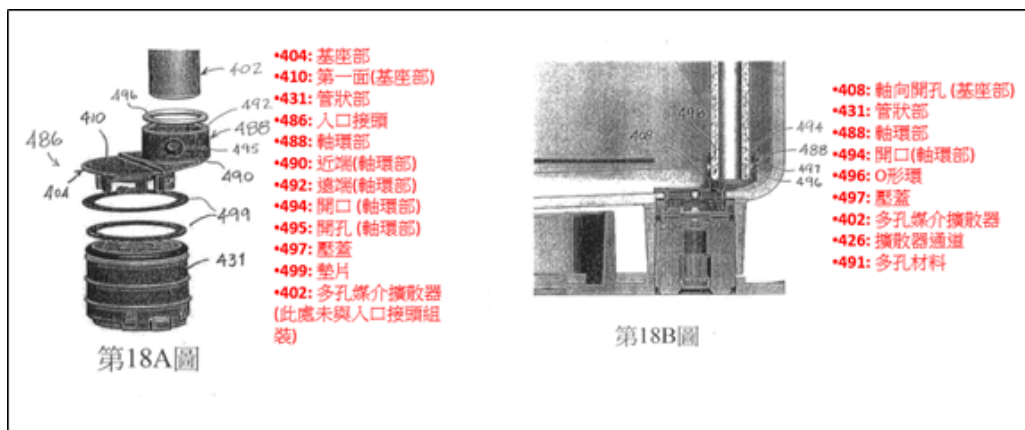


圖18A係一入口接頭之分解立體圖，其中展示了入口接頭的基座部、軸環部、O形環、墊片和多孔媒介擴散器；圖18B係一基板載具中之圖18A之入口接頭之組裝圖，其中展示了入口接頭安裝在基板容器的底壁上，並與多孔媒介擴散器配合。

(三)乙證6：

1.技術內容：

乙證6揭露一種可在不同處理設備之間移轉的基板收納容器包含界定一基板收納區域(5)之一容器本體(1)、設置於該殼體上之一歧管基底(50, 12)及二擴散器(52)。該容器本體包含一前開口、第一側壁、一第二側壁、一後壁及一底板

(6)。該歧管基底(50, 12)具有經組態以接收一清洗氣體流之一入口埠。該等分開之擴散器(52, 53)經組態以將該清洗氣體流分配至該基板收納區域(5)中。更明確地，乙證6揭露一種一前開式晶圓容器(FOUP)內之歧管基底(50, 12)，用於藉由將來自一共同入口埠之清洗氣體流劃分給每一個離散擴散器(52)來將清洗氣體流分配至基板收納容器之基板收納區域(5)中。

2.主要圖式：

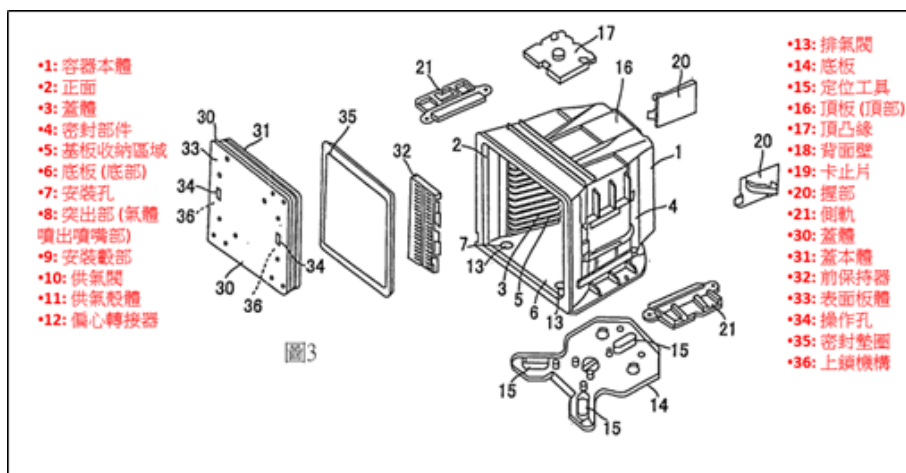


圖3係一基板收納容器之分解立體說明圖，其中展示了容器本體、蓋體、支撐片、位置限制部、安裝孔、供氣閥、排氣閥、定位工具、握部和側軌。

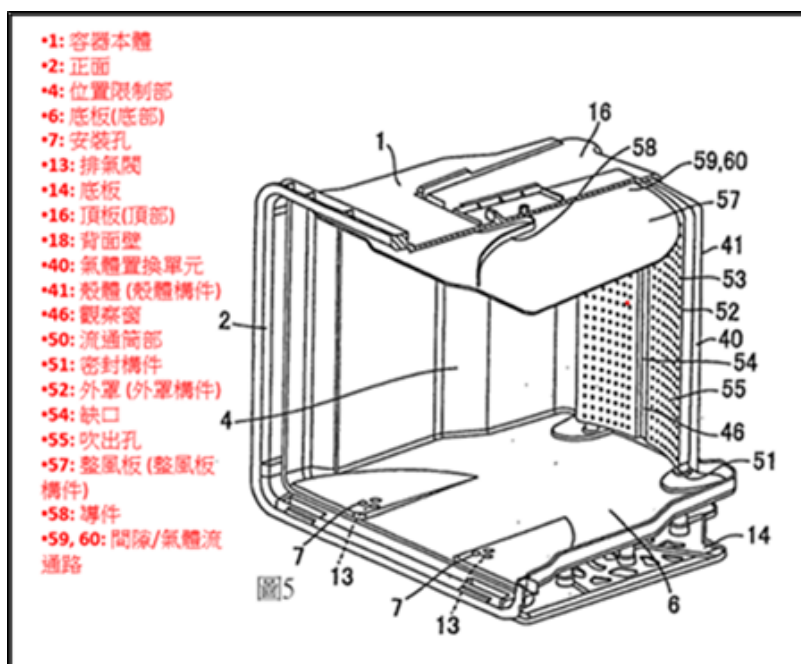


圖5係一未完成的容器本體之一部分的狀態之立體說明圖，其中展示了容器本體的頂板、背面壁、側壁和安裝孔，以及氣體置換單元的殼體、外罩、過濾器、整風板、貯留空間、觀察窗、流通筒部、缺口和吹出孔。

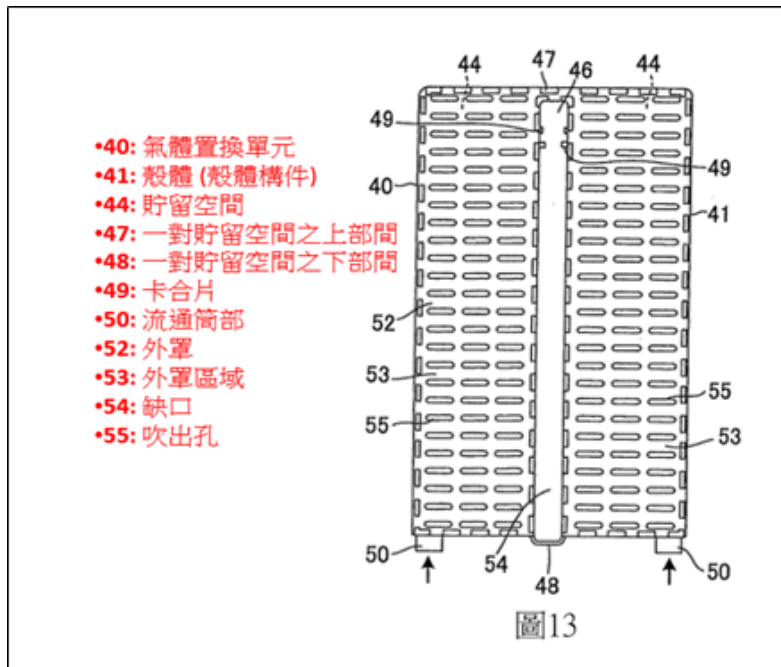


圖13係一氣體置換單元的殼體之正面說明圖，其中展示了殼體的貯留空間、觀察窗、卡合片、流通筒部、吹出孔和缺口。

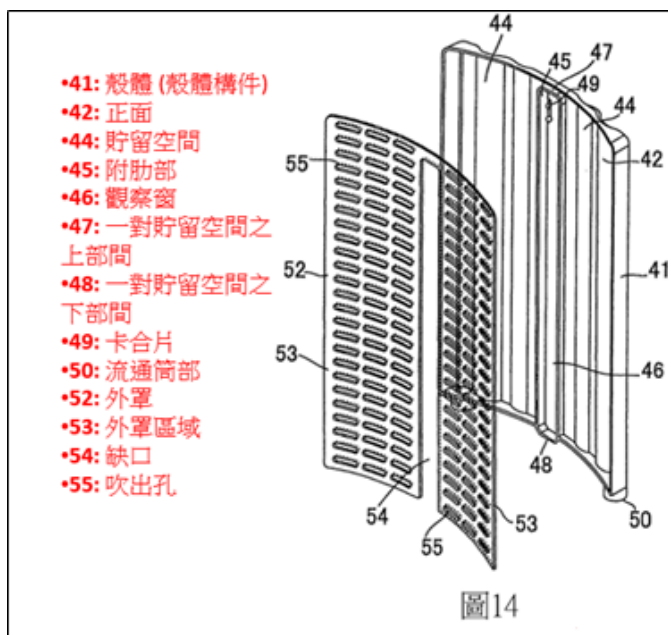


圖14係一氣體置換單元的殼體與外罩之分解立體說明圖，其中展示了殼體的貯留空間、觀察窗、卡合片、流通筒部和吹出孔，以及外罩的外罩區域、缺口和吹出孔。

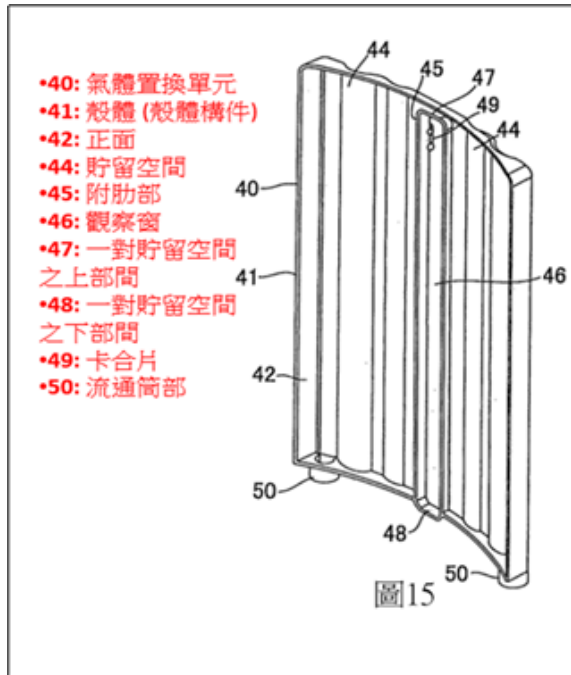


圖15係一氣體置換單元的殼體之立體說明圖，其中展示了殼體的貯留空間、觀察窗、卡合片、流通筒部和吹出孔。

(四)乙證8：

1.技術內容：

乙證8揭露一種基板收納容器(1)，包含一容器主體(2)，具備筒狀的壁部(20)，該壁部(20)在一端部具有形成有容器主體開口部(21)的開口周緣部(28)，且另一端部被封閉，利用壁部(20)的內表面形成能夠收納多個基板(W)且與容器主體開口部(21)連通的基板收納空間(27)；一蓋體(3)，能夠相對於容器主體開口部(21)拆裝，並能夠封閉容器主體開口部(21)；一氣道(210)，能夠將基板收納空間(27)與容器主體(2)的外部空間之間連通；以及作為氣體噴出噴嘴部(8)的突出部(8)，具有將流入到氣道(210)的氣體向基板收納空間(27)供給的多個開口部(802)，其中基板收納容器(1)具有一氣體流量均勻化部(801)，該氣體流量均勻化部(801)能夠從多個開口部(802)以均勻化後的流量流出氣體；該氣體噴出噴嘴部(8)具有一清洗液流入阻礙部(815C)，該清洗液流入阻礙部(815C)在清洗容器主體(2)時，在多個開口部(802)的附近阻礙清洗液從多個開口部(802)流入氣道(210)側。

2.主要圖式：

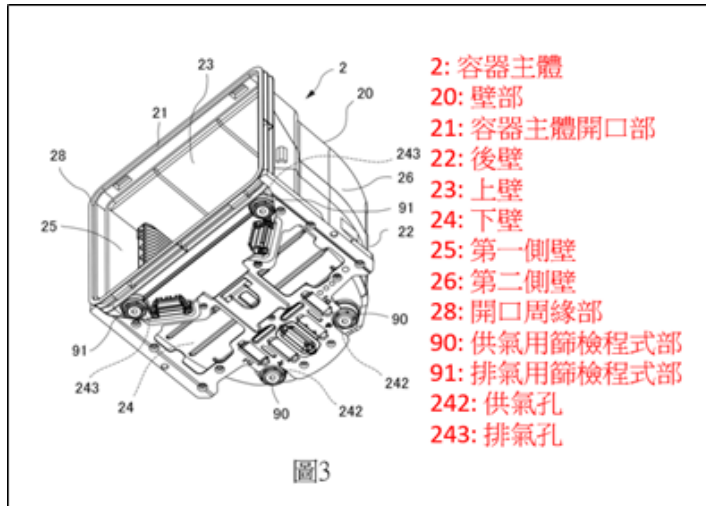


圖3係一容器主體之下方立體圖，其中展示了容器主體的下壁、側壁、後壁，以及供氣孔、排氣孔、供氣用篩檢程式部和排氣用篩檢程式部。

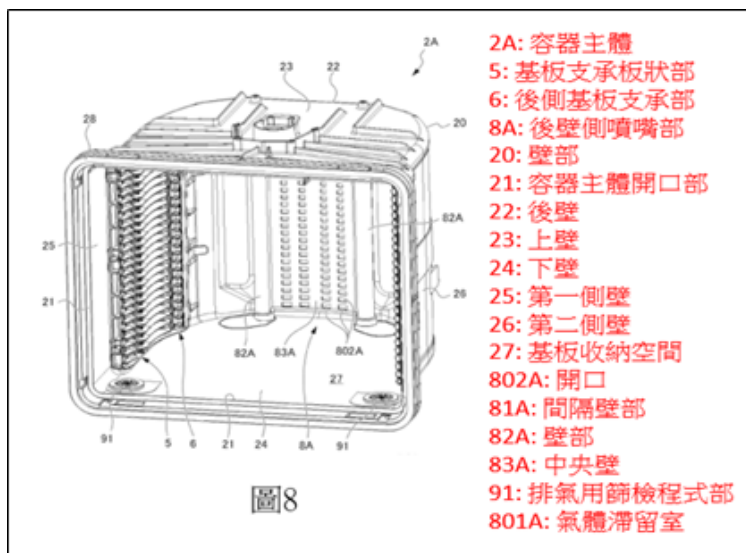


圖8係一容器主體的上方立體圖，其中展示了容器主體的后壁、側壁、上壁，以及後壁側噴嘴部、開口部、氣體滯留室和間隔壁部。

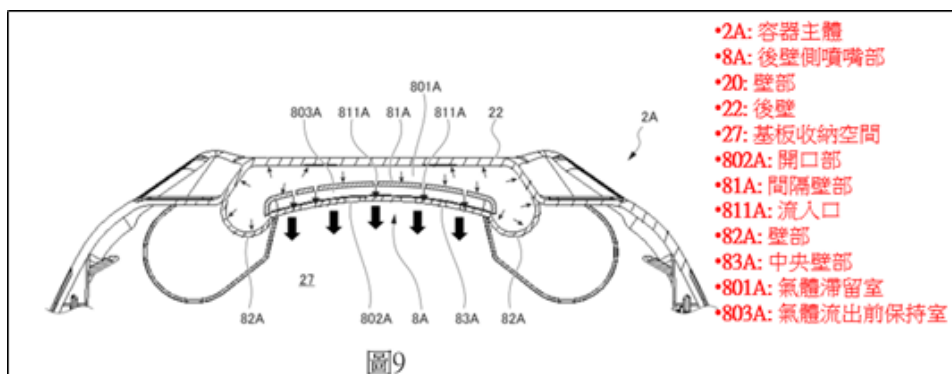


圖9係一後壁側噴嘴部之上方剖視圖，其中展示了後壁側噴嘴部的中央壁部、大致圓筒狀壁部、開口部、氣體滯留室和間隔壁部。

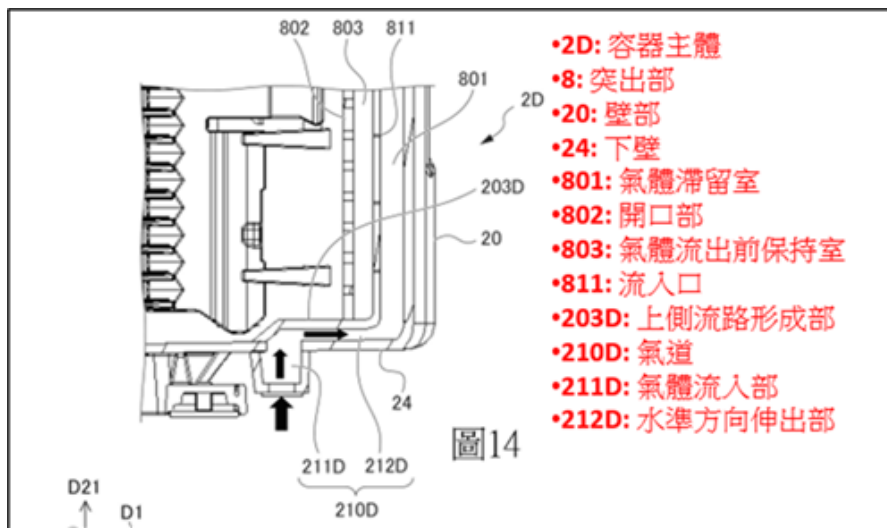


圖14係一容器主體之放大側方剖視圖，其中展示了容器主體的壁部、氣道和氣體噴出噴嘴部，以及氣道的氣體流入部、水準方向伸出部，還有突出部的開口部、氣體滯留室、氣體流出前保持室和間隔壁部。

(五)乙證9：

1.技術內容：

乙證9揭露一種微特徵工件固持器(100)，包含一基座(110)；複數個柱子(120)；以及一蓋子(150)，其中各柱子(120)包括複數個沿其長度縱向間隔的工件支撐，形成槽(122)；以及一氣體分配器(130)，包括至少一個氣體輸送導線管(134)，該氣體輸送導線管(134)係調適成相對於工件(W)而引導處理氣體流，其中該氣體輸送導線管(134)包括複數個橫向通道(136)，各橫向通道(136)將流體從氣體輸送導線管(134)引導至複數個出口(138)之一中，該等出口(138)係置放在二個鄰近槽(122)之間。

2.主要圖式：

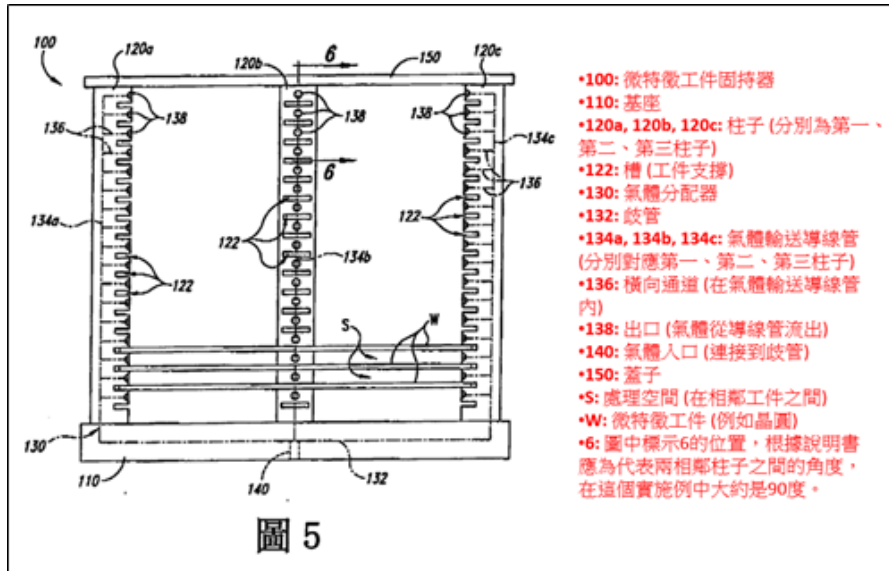


圖5係一微特徵工件固持器之側面正視圖，其中展示了基座、柱子、蓋子、槽、處理空間、氣體分配器、氣體輸送導線管、歧管、氣體入口和出口，以及基板和後側基板支承部等元件。

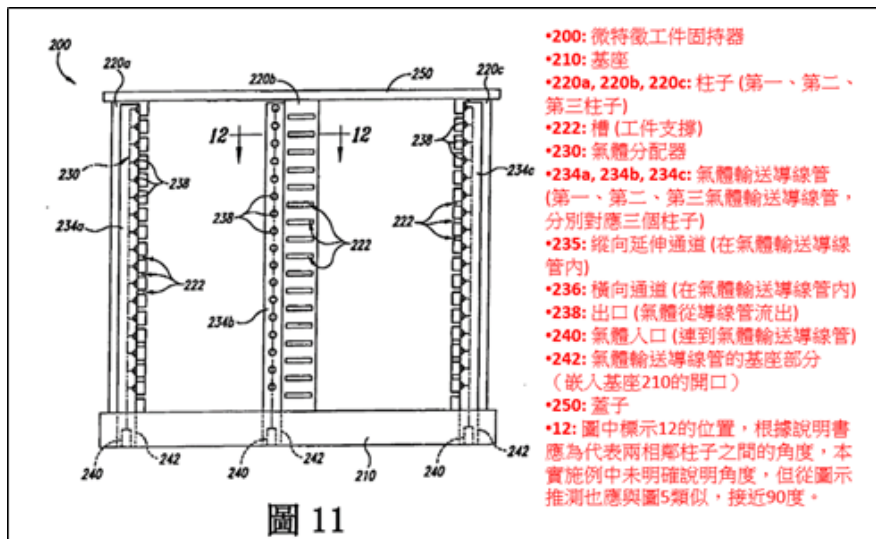


圖11係一微特徵工件固持器之側面正視圖，其中展示了基座、柱子、蓋子、槽、氣體分配器、氣體輸送導線管、氣體入口、出口和基座部分，此圖與圖5類似，但氣體分配器的設計不同，它有單獨的氣體入口，而不是單個由歧管供氣的入口。

(六)乙證11：

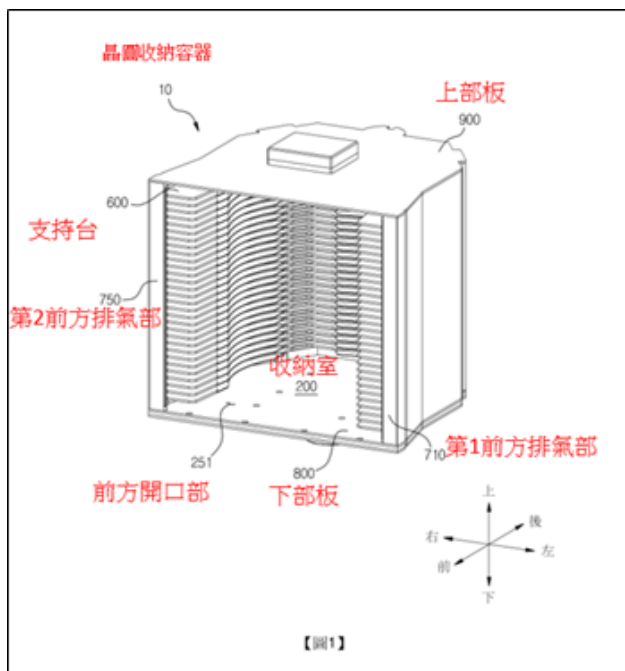
1.技術內容：

乙證11揭露一種晶圓收納容器(10)，包含：一收納室(200)，該收納室藉由前方開口部(251)收納晶圓(W)，所述收納

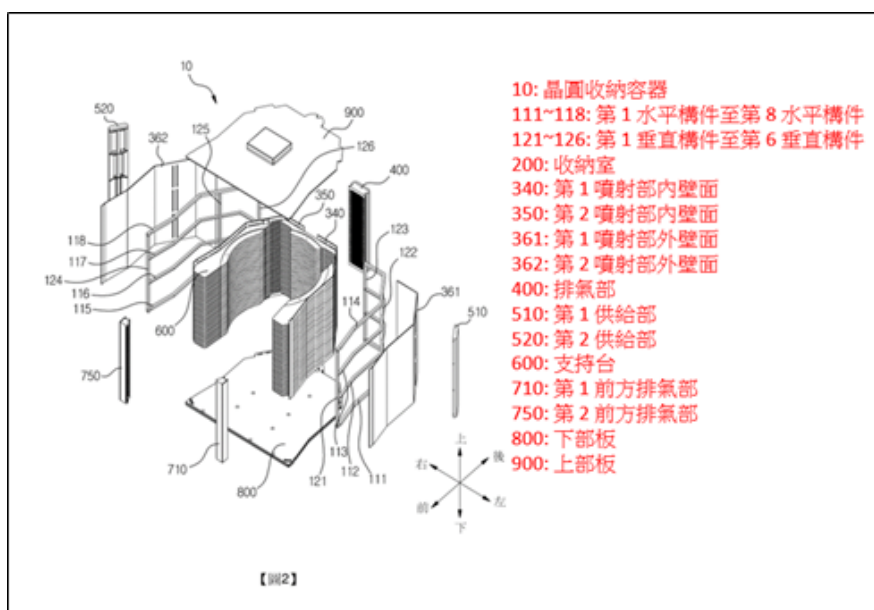
室(200)可沿垂直方向劃分成多個吹掃區域(例如210, 220, 230)；複數個噴射部(例如310, 320, 330)，向所述收納室(200)噴射吹掃氣體，其中各噴射部個別地對應各吹掃區域而噴射，且各噴射部包含一噴射部內壁面(例如340, 350)，其上形成有複數個噴射孔(390)；一排氣部(400)，用以排放所述收納室(200)的吹掃氣體及煙霧，所述排氣部(400)包含一排氣部內壁面(440)，其上形成有複數個排氣孔(490)；至少一供給部(例如510, 520)，用以向所述噴射部供給吹掃氣體，所述供給部包含複數個供給空間(例如531a-533d)及與之連通的垂直供給流路(例如541a-543d)；一下部板(800)，構成所述收納室(200)的底面，該下部板(800)可由複數個板體(810, 820, 830)疊合而成，其內部形成有供給連通孔(例如811a-813d)、供給流路(例如821a-823d)、流入孔(例如831a-833d)，以及與排氣部(400)連通的排氣連通孔(例如815a-817c)與排氣流路(例如826a-827c)；一連接構件(850)，設置於所述下部板(800)的下方，其包含主流入孔(例如851a-853b)以接收外部供給的吹掃氣體，並將其分配至所述下部板(800)內的供給流路，該連接構件(850)另包含整合排出流路(855)及主排氣孔(857)以匯集從所述下部板(800)排出的氣體；以及一支持台(600)，設置於所述收納室(200)內部用以支持晶圓(W)。該容器另可包含第1前方排氣部(710)及第2前方排氣部(750)。

2.主要圖式：

01



02 圖1係晶圓收納容器的立體圖，展示了容器整體外觀，包括
 03 上蓋、下部板、收納室、支持台以及前、後、側壁和排氣口
 04 等主要部件。
 05



06 圖2係晶圓收納容器的分解立體圖，將圖1的容器分解，展示
 07 了內部結構，例如噴射部、排氣部、供給部、水準構件、垂
 08 直構件等。

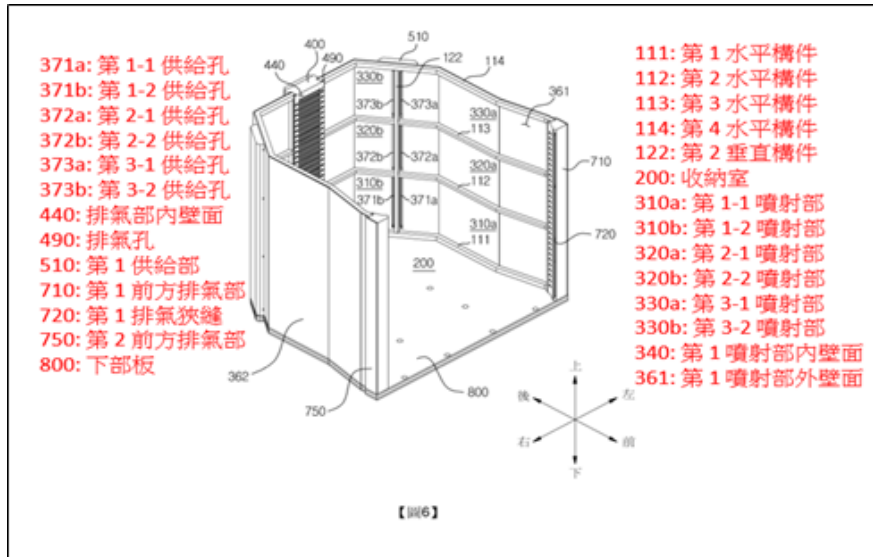


圖6係收納室左側部分的局部立體圖，詳細展示了第1噴射部（由第1-1至1-4噴射部組成）到第3噴射部（由3-1至3-4噴射部組成）的左半部分（1-1、2-1、3-1、1-2、2-2、3-2），以及第1前方排氣部，展示了供給孔、噴射部內外壁面、排氣狹縫等。

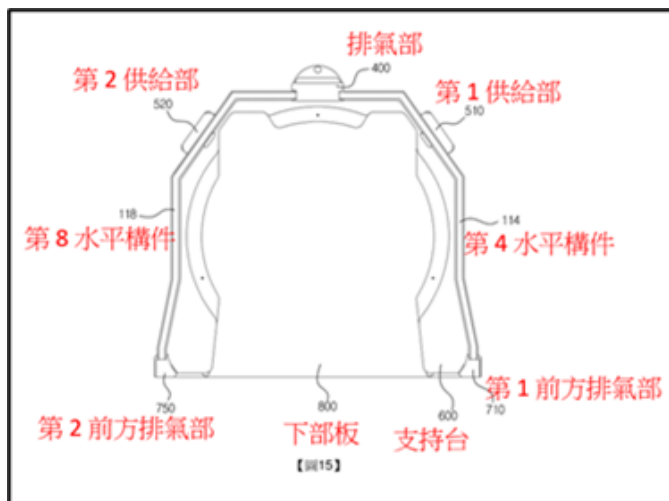
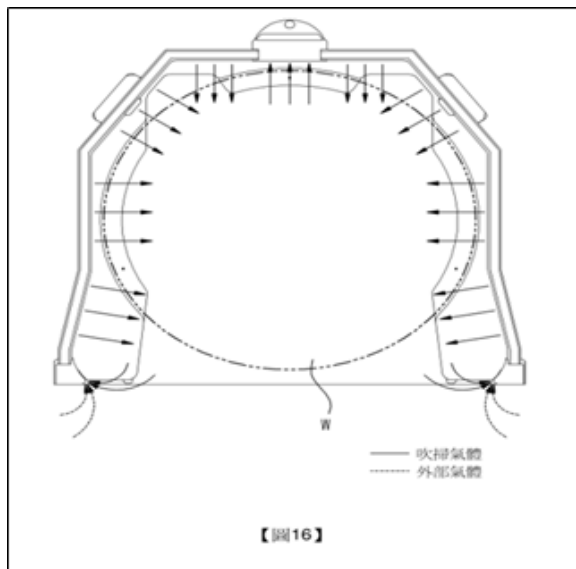


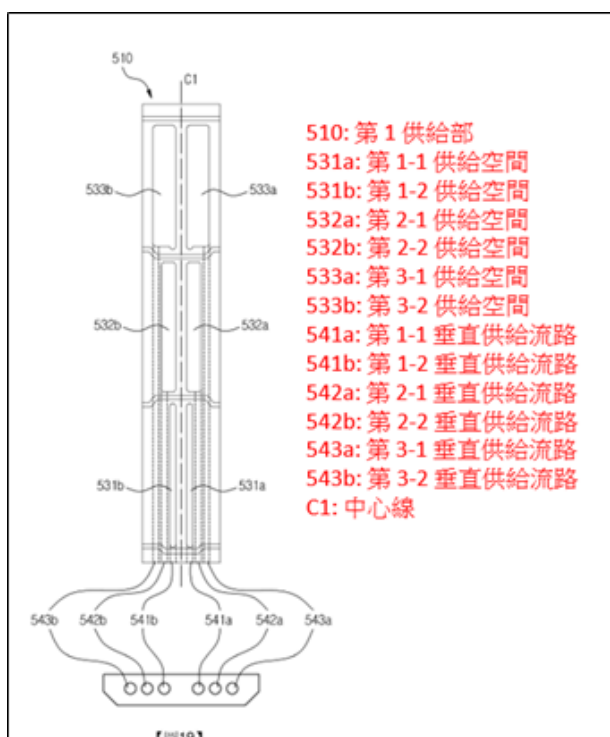
圖15係晶圓收納容器的俯視剖面圖，展示了供給部、噴射部、排氣部和支持台的相對位置以及大致形狀。

01



02 圖16係俯視剖面圖，展示吹掃氣體如何從噴射部噴出，流經
03 晶圓(W)，最後經排氣部排出。也展示了外部氣體的流動方
04 向。

05



06 圖19係第1供給部的右側視圖，詳細展示了供給空間、垂直
07 供給流路和中心線。

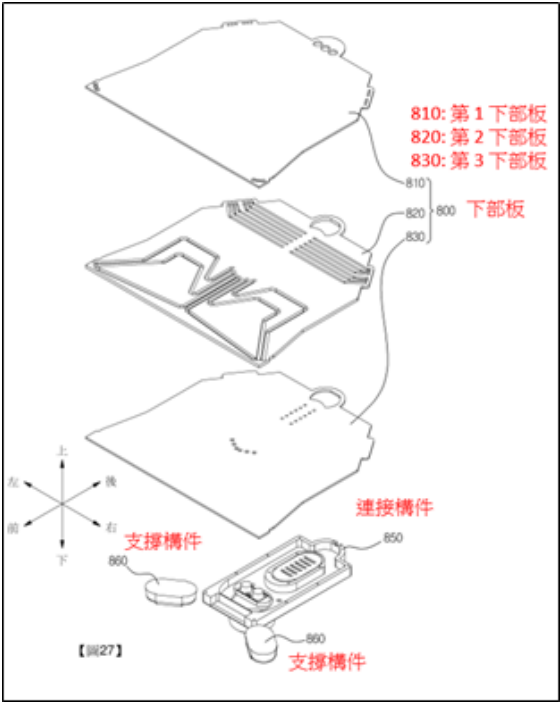


圖27係下部板的分解立體圖，展示了下部板由三個部分組成（第1、2、3下部板），以及連接構件和支撐構件。

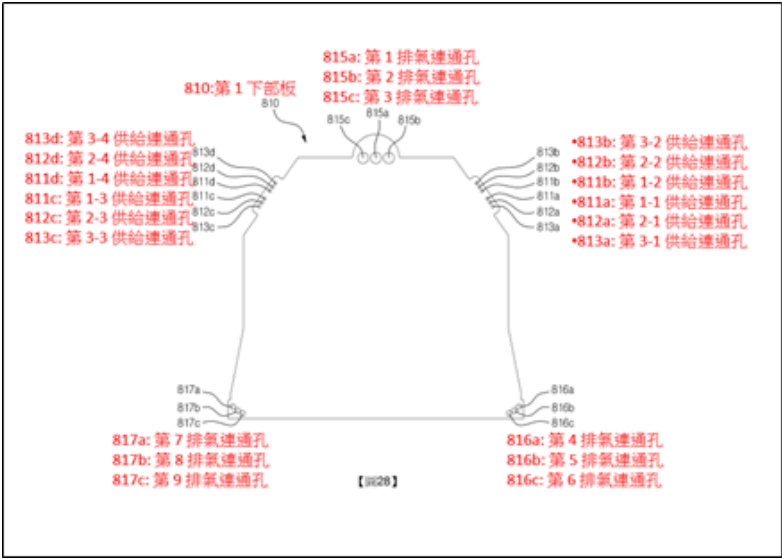
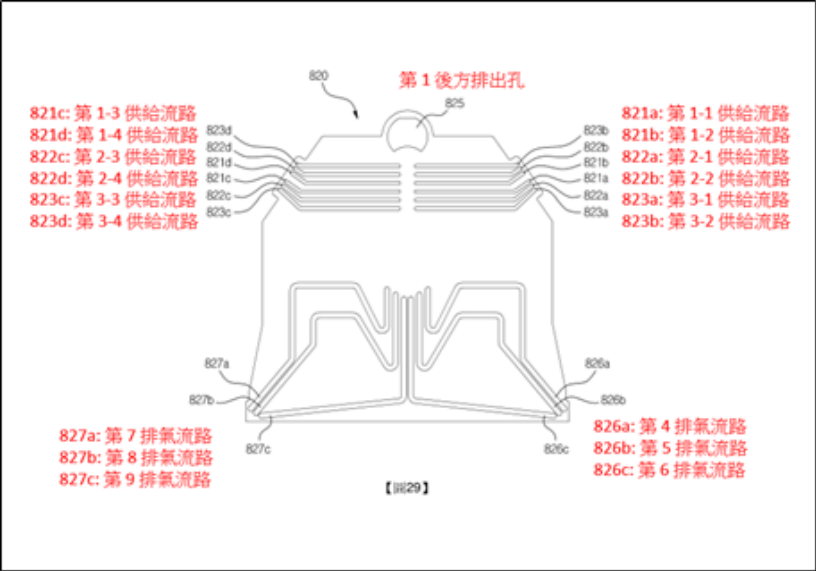


圖28係第1下部板的俯視圖，展示了供給連通孔和排氣連通孔的位置和數量。

01

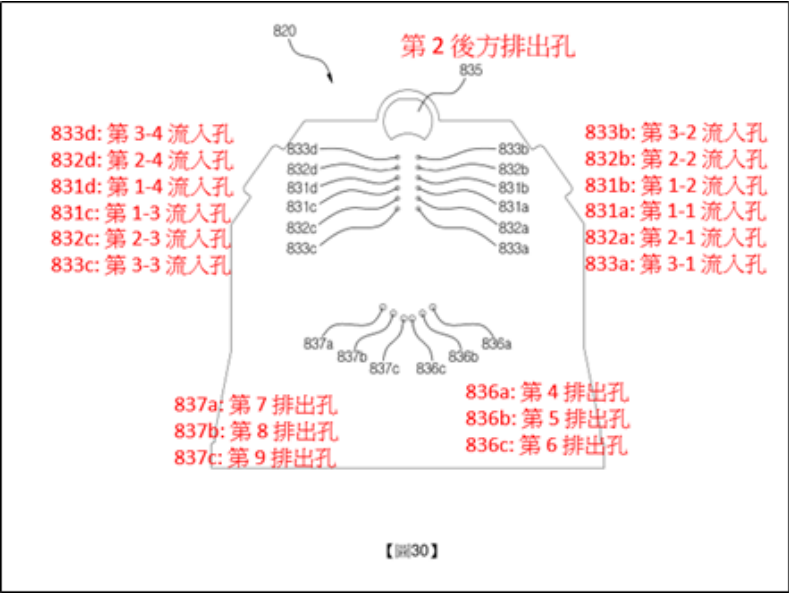


02

03

04

圖29係第2下部板的俯視圖，展示了供給流路、後方排出孔和排氣流路的位置。



05

06

圖30係第3下部板的俯視圖，展示了流入孔、後方排出孔和排出孔的位置。

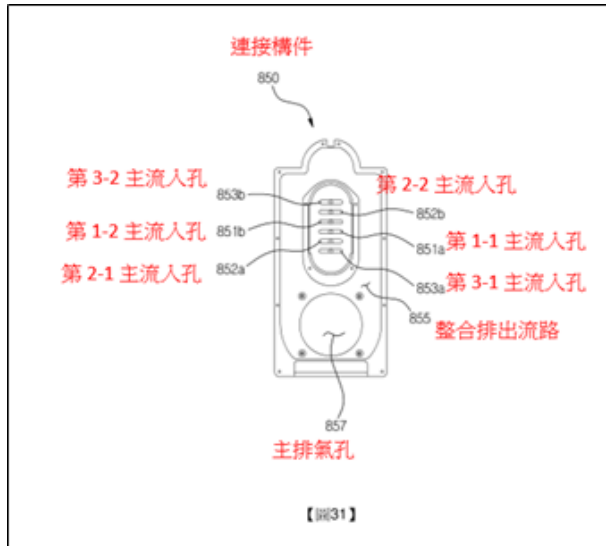


圖31係連接構件的俯視圖，展示了主流入孔、整合排出流路
和主排氣孔。

九、系爭產品落入系爭專利請求項15至17之文義範圍、請求項18
之均等範圍：

(一)系爭產品與系爭專利請求項15之比對說明：

1.系爭專利請求項15之技術特徵可解析為4個要件，分別
為：

(1)要件編號15A：一種基板容器，其包括：一殼體，其界定一
內部空間，該殼體包含一前開口、一第一側壁、一第二側
壁、一後壁及一底壁，該底壁包含沿該殼體之該前開口在該
第一側壁與該第二側壁之間延伸之一前邊緣，其中複數個入
口清洗埠被提供於該殼體之該底壁上；

(2)要件編號15B：一歧管基底，其設置於該殼體之外部並附接
於該底壁上之該複數個入口清洗埠，其中該歧管基底具有經
組態以接收一清洗氣體流之複數個入口埠，且該歧管基底包
含連接至該複數個入口埠之一流動路徑；及

(3)要件編號15C：複數個管狀擴散器，其經由該複數個入口清
洗埠與該歧管基底連通，以用於將該清洗氣體流分配至該殼
體之該內部空間中，

(4)要件編號15D：其中，該歧管基底之該流動路徑將來自該複
數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分，並經由該複數
個入口清洗埠將該清洗氣體流供應至該複數個管狀擴散器。

01 2.系爭產品落入系爭專利請求項15之文義範圍：

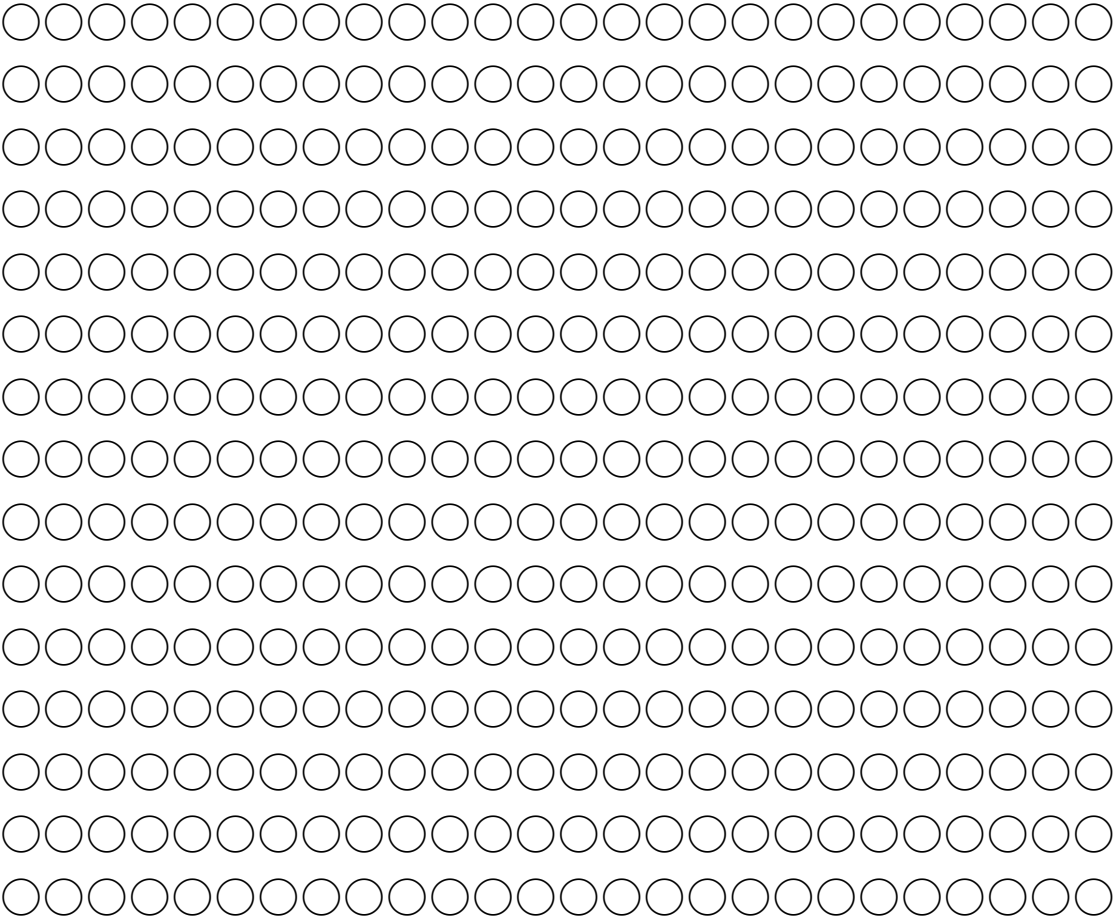
02 (1)要件編號15a：依系爭產品照片(參本院限閱卷一第73、85、
03 102頁系爭產品之勘驗照片，下圖標註各元件位置)可知「基
04 板容器」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「基板容
05 器」；「殼體」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一
06 殼體」；「前開口」可對應系爭專利請求項15要件編號15A
07 「一前開口」；「第一側壁」、「第二側壁」、「後壁」可
08 對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第一側壁、一第二
09 側壁、一後壁」；「底壁」○○○○○○○○○○○○○○○○○○
10 ○○可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一底壁」。因
11 此，系爭產品被系爭專利請求項15要件編號15A「一種基板
12 容器，其包括：一殼體，其界定一內部空間，該殼體包含一
13 前開口、一第一側壁、一第二側壁、一後壁及一底壁」之文
14 義所讀取。

15 (2)要件編號15b：依系爭產品照片(參本院限閱卷一第109頁系
16 爭產品之勘驗照片，下圖標註各元件位置)可知○○○○○
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，故可對應系爭專
18 利請求項15要件編號15B「一歧管基底，其設置於該殼體之
19 外部」；○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○可對應系爭專
20 利請求項15要件編號15B「並附接於該底壁上之該複數個入
21 口清洗埠」；○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
22 ○○○○○○可對應系爭專利請求項15要件編號15B「該歧管
23 基底具有經組態以接收一清洗氣體流之複數個入口埠」；○
24 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，可
25 對應系爭專利請求項15要件編號15B「該歧管基底包含連接
26 至該複數個入口埠之一流動路徑」。因此，系爭產品被系爭
27 專利請求項15要件編號15B「一歧管基底，其設置於該殼體
28 之外部並附接於該底壁上之該複數個入口清洗埠，其中該歧
29 管基底具有經組態以接收一清洗氣體流之複數個入口埠，且

該歧管基底包含連接至該複數個入口埠之一流動路徑；及」
之文義所讀取。

(3)要件編號15c：依系爭產品照片(參本院限閱卷一第85頁系爭產品之勘驗照片，下圖標註各元件位置)可知○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○可對應系爭專利請求項15要件編號15C「複數個管狀擴散器，其經由該複數個入口清洗埠與該歧管基底連通，以用於將該清洗氣體流分配至該殼體之該內部空間中，」。因此，系爭產品被系爭專利請求項15要件編號15C「複數個管狀擴散器，其經由該複數個入口清洗埠與該歧管基底連通，以用於將該清洗氣體流分配至該殼體之該內部空間中，」之文義所讀取。

(4)要件編號15d：依系爭產品照片(參本院限閱卷一第183頁系爭產品之勘驗照片，下圖標示出清洗氣體之流動路徑)可知



可對應

系爭專利請求項15要件編號15D「其中，該歧管基底之該流動路徑將來自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分，並經由該複數個入口清洗埠將該清洗氣體流供應至該複數個管狀擴散器」。因此，系爭產品被系爭專利請求項15要件編號15D「其中，該歧管基底之該流動路徑將來自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分，並經由該複數個入口清洗埠將該清洗氣體流供應至該複數個管狀擴散器」之文義所讀取。

(二)系爭產品落入系爭專利請求項16之文義範圍：

系爭專利請求項16係請求項15之附屬項，包含請求項15全部技術特徵，系爭產品落入系爭專利請求項15文義範圍，業如前述，又依系爭產品照片(參本院限閱卷一第82頁系爭產品之勘驗照片，下圖標註各元件位置)可知○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，可對應系爭專利請求項16「其中該歧管基底設置於該殼體與一載板之間」。因此，系爭產品被系爭專利請求項16「如請求項15之基板容器，其中該歧管基底設置於該殼體與一載板之間」之文義所讀取。

(三)系爭產品落入系爭專利請求項17之文義範圍：

系爭專利請求項17係請求項15之附屬項，包含請求項15全部技術特徵，如前所述，系爭產品落入系爭專利請求項15文義範圍，又依系爭產品照片(參本院限閱卷一第84頁系爭產品之勘驗照片，下圖標註各元件位置)可知○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○可對應系爭專利請求項17「其中該複數個管狀擴散器之一者該至少一擴散器經設置為較靠近該殼體之該後壁」。因此，系爭產品被系爭專利請求項17「如請求項15之基板容器，其中該複數個管狀擴散器之一者該至少一擴散器經設置為較靠近該殼體之該後壁」之文義所讀取。

(四)系爭產品落入系爭專利請求項18之均等範圍：

○○○○○○○○○○○○，故符合系爭專利請求項15「組合且接著劃分」，故被告前開所辯顯非可採。

十、系爭專利說明書未違反專利法第26條第1項規定：

(一)系爭專利說明書段落[0050]及[0053]已載明流動路徑與入口埠之連接關係，以圖5B配合說明書文字之引導，通常知識者無須經過過度實驗即可理解系爭專利中如何將歧管基底配置於殼體與載板之間，並完成各組件間之氣體流路對接，且關於左側及右側流動路徑之描述屬空間方位之相對說明，配合載板之位置配置，通常知識者自能瞭解其內容並可據以實現，符合專利法第26條第1項規定。

(二)被告雖辯稱：圖5B僅為歧管基底示意圖，未顯示「入口清洗埠」位置，導致無法得知歧管基底560與底壁的入口清洗埠之附接方式云云(本院卷四第165頁)。惟查，專利圖式之主要作用在於補充說明書文字描述之不足，其核心目的在於協助該技術領域中具有通常知識者透過視覺輔助來理解發明的各個技術特徵及其所構成之技術手段，因此圖式並非精密操作手冊，不需要將發明物的所有細微元件鉅細靡遺地標註出來，專利權的保護範圍主要是由申請專利範圍之文字所界定，圖式僅作為解釋請求項或判斷發明是否符合可據以實現要件時之參考依據，只要圖式能與文字相互配合並使讀者清楚得知發明內容進而據以實現，即已符合法律上之揭露義務(參專利審查基準第二篇第一章第2-1-38頁)。況系爭專利其他圖式，如圖5A已清楚顯示清洗流體分配系統540包含歧管基底560係介於殼體底壁與載板之間，圖2又揭露具系爭專利基板容器之底部有複數個入口清洗埠(30A、30B、30C)，又說明書段落[0050]已明確記載歧管基底具備連接至入口清洗埠之流動路徑，故發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌圖2、5A、5B之組裝關係及說明書文字描述，無須經過過度實驗即可知悉如何將該基底附接於底壁，故被告所辯即不足採。

01 (三)被告復辯稱：圖5B未顯示載板上之入口埠，難以理解流動路
02 徑560A、560B如何連接入口埠云云(本院卷四第166頁)。惟
03 查，專利文件之判讀應將說明書、申請專利範圍及圖式一體
04 觀之。雖然圖5B專注於呈現歧管基底本身之構造，但圖5C已
05 明確揭露載板523上之數個入口埠505A至505D之配置。通常
06 知識者配合圖5C與說明書第[0053]段之文字引導，自能理解
07 歧管基底之流動路徑如何對接並接收來自該等入口埠之氣
08 體，被告將個別圖式割裂觀察而辯稱無法據以實現，顯無理
09 由。

10 (四)被告又辯稱：圖5B未顯示入口埠，難以理解流動路徑560A、
11 560B如何區分左側及右側流動路徑云云(本院卷四第166
12 頁)。惟查，說明書段落[0050]及[0053]已具體描述氣體供
13 應至歧管基底後之分配方式，且「左側」與「右側」係本發
14 明技術領域中對於氣流分佈之相對空間方位描述，通常知識
15 者本於對半導體容器清洗氣路配置之專業素養，參酌圖5B所
16 示之分流構造及圖5C之對應位置，即可輕易理解並完成將清
17 洗氣體劃分為至少一左側及一右側路徑，並不因圖5B未重複
18 標示入口埠而影響其揭露之充分性，故被告所辯亦無理由。

19 □、系爭專利請求項15無不明確，且為說明書所支持，未違反專
20 利法第26條第2項之規定：

21 (一)查系爭專利說明書段落[0005]、[0049]及[0053]已載明清洗
22 流體分配系統包含提供於底壁上之歧管基底，且該歧管基底
23 係實施供應管線功能之具體構造，配合圖5B及圖5C揭露之內
24 部流動路徑與入口埠配置，通常知識者參酌說明書及申請專
25 利範圍之整體記載，自能理解歧管基底係附接於底壁之入口
26 清洗埠，並透過流動路徑對接載板上之入口埠以接收氣體，
27 且關於管狀擴散器與歧管基底之連通，乃屬同一分配系統下
28 各組件之氣路整合，並非不同實施例之拼湊，說明書關於供
29 應管線組合及劃分流體之功能性描述，亦足以支持具備歧管
30 本質之基底構造特徵，故請求項15之技術特徵明確且為說明
31 書所支持，符合專利法第26條第2項之規定。

01 (二)被告雖辯稱：請求項15所載「一歧管基底，其設置於該殼體
02 之外部並附接於該底壁上之該複數個入口清洗埠」技術特徵
03 不為說明書所支持云云(本院卷四第170至171頁)。惟查，說
04 明書第[0005]段已明確指出，清洗流體分配系統進一步包含
05 提供於該底壁上之一「歧管基底」，且說明書第[0029]段揭
06 露「基板容器1可在底壁22上包含對應於基板容器1之入口
07 及/或出口之複數個入口清洗埠及/或出口清洗埠(例如圖2
08 之30A、30B、30C等等)……」，故所屬技術領域具通常知
09 識者能輕易理解歧管基底作為分配系統之核心部件，其設置
10 於底壁上即係為了對接並附接於底壁之入口清洗埠，以接收
11 並分配氣體，顯見系爭專利說明書已充分支持系爭專利請求
12 項15之技術特徵，故被告前開所辯顯屬無稽。

13 (三)被告復辯稱：請求項15所載「該歧管基底包含連接至該複數
14 個入口埠之一流動路徑」技術特徵不為說明書所支持云云
15 (本院卷四第171頁)。惟查，系爭專利說明書第[0053]段已
16 明確記載清洗氣體可供應至載板提供之「數個入口埠505A-5
17 05D」，並供應至「歧管基底560」，配合圖5B顯示基底內部
18 之流動路徑560A、560B，所屬技術領域具通常知識者參酌圖
19 式與文字說明，自能理解該等流動路徑必然連接至入口埠以
20 接收氣體，此特徵係由說明書及圖式整體所支持，故被告前
21 開所辯亦屬無稽。

22 (四)被告又辯稱：請求項15所載「複數個管狀擴散器，其經由該
23 複數個入口清洗埠與該歧管基底連通」與「經由該複數個入
24 口清洗埠將該清洗氣體流供應至該複數個管狀擴散器」技術
25 特徵不為說明書所支持云云(本院卷四第171至172頁)。惟
26 查，系爭專利說明書第[0021]段揭露「……所描繪之繪示性
27 實施例僅意欲為例示性。任何繪示性實施例之選定特徵可併
28 入至一額外實施例中，除非有相反明確闡述」，故系爭專利
29 說明書所載實施例本得相互參酌。說明書第[0039]及[0041]
30 描述之氣體分配裝置(包含管狀擴散器/氣體塔)與段落[00
31 50]描述之歧管基底流動路徑，皆屬於「清洗流體分配系

01 統」之組成部分。將氣體由基底經由埠位供應至擴散器，乃
02 該技術領域之常見配置，所屬技術領域具通常知識者從說明
03 書整體架構中可清楚得知其連通關係，無須逐字對應亦能獲
04 得支持，故被告前開所辯顯屬無據。

05 (五)被告再辯稱：請求項15所載「該歧管基底之該流動路徑將來
06 自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分」技術特
07 徵不為說明書所支持云云(本院卷四第172至173頁)。惟查，
08 系爭專利說明書第[0049]段已明文記載「清洗流體分配系統
09 540包含至少一個供應管線……包含提供於底壁522上之一歧
10 管基底560」，這表示歧管基底即係實施該「供應管線」功
11 能之具體構造部件，所屬技術領域具通常知識者應能理解歧
12 管基底之「歧管」本義即具備組合與劃分流體之功能，況系
13 爭專利圖3B以及說明書第[0038]段揭露「清洗氣體之供應可
14 自來自入口埠305A、305B之供應管線之管道之接合混合/組
15 合，或(例如)使用一線上混合器混合，且接著劃分/分離
16 至不同流動路徑360A、360B中」。因此，針對供應管線功能
17 之描述，理所當然支持作為其具體實施方式之歧管基底，並
18 無不明確或欠缺支持之情形，被告前開所辯亦屬無據。

19 □、乙證2不足以證明系爭專利請求項15至18不具新穎性：

20 (一)乙證2不足以證明系爭專利請求項15不具新穎性：

21 1.乙證2已揭露系爭專利請求項15要件編號15A：

22 乙證2說明書揭露「根據本發明之較佳例示性實施例之晶圓
23 儲存容器10包含：儲存腔室100，其中晶圓W儲存在儲存腔室
24 100中……」(參乙證2說明書第[0087]段，圖1至圖3，本院
25 卷二第108頁)；乙證2說明書揭露「儲存腔室100表示從第
26 一分隔壁150a至第六分隔壁150f向內部形成之空間，並且具
27 有前部開口，該前部開口之前側係開放的」(參乙證2說明
28 書第[0089]段，本院卷二第109頁)；乙證2說明書揭露「第
29 六氣體腔室200f之左表面及右表面分別藉由第六外壁210f及
30 第六分隔壁150f來形成」(參乙證2說明書第[0130]段，本
31 院卷二第118頁)；乙證2說明書揭露「第一分隔壁150a及第

二分隔壁150b形成儲存腔室100之左前部及右前部外表面……第五分隔壁150e及第六分隔壁150f形成儲存腔室100之後部表面」（參乙證2說明書第[0090]段，本院卷二第109頁）；乙證2說明書揭露「第一下部板400形成儲存腔室100之底部表面」（參乙證2說明書第[0090]段，本院卷二第109頁）；乙證2說明書揭露「穿透第一下部板400之上部表面及下部表面的第一連通孔450a至第六連通孔450f分別形成在下部板400……第一連通孔450a至第四連通孔450d發揮將……氣體分別引入第一氣體腔室200a至第四氣體腔室200d中的作用」（參乙證2說明書第[0175]、[0177]段，圖8，本院卷二第128頁）。其中「晶圓儲存容器10」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一種基板容器」；「第一下部板400、上部板300、外壁210a-f」之元件組合整體可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一殼體」；「儲存腔室100」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一內部空間」；「前部開口」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一前開口」；「第一外壁210a及第一分隔壁150a」等組合可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第一側壁」；「第二外壁210b及第二分隔壁150b」等組合可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第二側壁」；「第六外壁210f」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一後壁」；「第一下部板400」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一底壁」；「第一下部板400」位於「前部開口」處延伸之邊緣可對應系爭專利請求項15要件編號15A「該底壁包含沿該殼體之該前開口在該第一側壁與該第二側壁之間延伸之一前邊緣」；「第一至第四連通孔450a、450b、450c、450d」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「複數個入口清洗埠」；「連通孔450a-d形成於第一下部板400上」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「其中複數個入口清洗埠被提供於該殼體之該底壁上」，故乙證2已揭露系爭專利請求項15要件編號15A全部技術特徵。

2. 乙證2已揭露系爭專利請求項15要件：

系爭專利請求項15要件編號15B乙證2說明書揭露「第二下部板500位在第一下部板400與第三下部板600之間……第二下部板500及第三下部板600耦接至第一下部板400之下側」（參乙證2說明書第[0184]、[0223]段，圖2，本院卷二第130、138頁）。乙證2說明書揭露「第一通路510……包含：第一吸入孔511，第一分支通路512及第二分支通路513」；「第二通路520……包含：第二吸入孔521，第三分支通路522及第四分支通路523」（參乙證2說明書第[0186]、[0194]段，圖9，本院卷二第130、132頁）。其中「第二下部板500」、「第三下部板600」設置於第一下部板400下側，「第一下部板400」、「第三下部板600」之間的空間(包含「第二下部板500」)可對應系爭專利請求項15要件編號15B「一歧管基底，其設置於該殼體之外部並附接於該底壁上之該複數個入口清洗埠」；「第一氣孔610、第二氣孔620」可對應系爭專利請求項15要件編號15B「該歧管基底具有經組態以接收一清洗氣體流之複數個入口埠」；「第一通路510、第二通路520」可對應系爭專利請求項15要件編號15B「該歧管基底包含連接至該複數個入口埠之一流動路徑」，故乙證2已揭露系爭專利請求項15要件編號15B全部技術特徵。

3. 乙證2未揭露系爭專利請求項15要件編號15C：

乙證2說明書揭露「第一氣體腔室200a至第六氣體腔室200f表示分別在第一外壁210a至第六外壁210f與第一分隔壁150a至第六分隔壁150f之間形成之空間區域」（參乙證2說明書第[0114]段，本院卷二第114頁）；乙證2說明書揭露「氣體引入第一氣孔610……流至第一連通孔450a並且填充在第一氣體腔室200a……沿著第二分支通路513流至第三連通孔450c並且填充在第三氣體腔室200c」（參乙證2說明書第[0229]段，本院卷二第139頁）；乙證2說明書揭露「填充在第一氣體腔室200a至第四氣體腔室200d內部之氣體可經由……第一分隔壁150a至第四分隔壁150d之複數個孔151均勻地供應至儲存腔室100」（參乙證2說明書第[0234]段，圖11，本院卷

二第140頁)。其中「第一至第四氣體腔室200a-200d」及「分隔壁150a-150f」之功能組合實質作為複數擴散器之用，且與「第一下部板400」、「第三下部板600」之間的空間(包含「第二下部板500」連通，故可對應系爭專利請求項15要件編號15C「複數個……擴散器，其經由該複數個入口清洗埠與該歧管基底連通，以用於將該清洗氣體流分配至該殼體之該內部空間中……」，但乙證2說明書未敘明該擴散器之外部形狀為「管狀」，故乙證2未揭露系爭專利請求項15要件編號15C全部技術特徵。

4. 乙證2未揭露系爭專利請求項15要件編號15D：

乙證2說明書揭露「第一通路510包含：第一吸入孔511，第一分支通路512及第二分支通路513……氣體引入第一氣孔610……沿著第一分支通路512流至第一連通孔450a……沿著第二分支通路513流至第三連通孔450c」(參乙證2說明書第[0186]、[0229]段，圖9，本院卷二第130、139頁)。其中第二下部板500內之「第一通路510、第二通路520」可對應系爭專利請求項15要件編號15D「該歧管基底之該流動路徑」；「第一氣孔610、第二氣孔620」可對應系爭專利請求項15要件編號15D「複數個入口埠」；乙證2說明書揭露，當晶圓儲存容器10耦接至載入埠時，載入埠之氣體供應噴嘴會耦接至第三下部板600之「第一氣孔610」及「第二氣孔620」(對應系爭專利之複數個入口埠)並與其連通。氣體經由前述複數個入口(610、620)引入第三下部板600與第二下部板500所組成之空間(比對為系爭專利請求項15之歧管基底)，惟其內部之第一通路510與第二通路520分屬不同空間，無法對應系爭專利請求項15要件編號15D清洗氣體流「將來自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分」之技術特徵，又乙證2未揭露「管狀擴散器」之理由已如前述，故乙證2未揭露系爭專利請求項15要件編號15D全部技術特徵。

01 (二)系爭專利請求項16至18係請求項15之附屬項，包含請求項15
02 全部技術特徵，乙證2不足以證明系爭專利請求項15不具新
03 穎性之理由，業如前述，乙證2亦不足以證明系爭專利請求
04 項16至18不具新穎性。

05 □、乙證11不足以證明請求項15至17不具新穎性：

06 (一)乙證11不足以證明請求項15不具新穎性：

07 1.乙證11已揭露系爭專利請求項15要件編號15A：

08 乙證11說明書揭露「如圖1至圖3所示，本發明的較佳的實
09 施例的晶圓收納容器10包括如下構件而構成：收納室20
10 0，收納藉由前方開口部251而收納的晶圓W……」(參乙證
11 11說明書第[0059]段，圖式1至3，本院卷五第103頁)；乙
12 證11說明書揭露「收納室200的上部面由上部板900構成，
13 收納室200的下部面由下部板800構成，收納室200的外圍
14 面由第1噴射部內壁面340及第2噴射部內壁面350與排氣部
15 內壁面440構成」(參乙證11說明書第[0063]段，本院卷五
16 第104頁)；乙證11說明書揭露「……第3-1噴射部330a及
17 第3-2噴射部330b的外側面由第1噴射部外壁面361構成……」
18 (參乙證11圖2之元件符號361以及元件符號對應
19 說明書第[0087]段，本院卷五第109頁)；乙證11說明書揭
20 露「第3-3噴射部330c及第3-4噴射部330d的外側面由第2
21 噴射部外壁面362構成……」(參乙證11圖2之元件符號362
22 以及元件符號對應說明書第[0092]段，本院卷五第110
23 頁)；乙證11說明書揭露「如圖28所示，第1下部板810構
24 成收納室200的底面，以貫通第1下部板810的上表面與下
25 表面的方式分別形成第1-1供給連通孔至第3-4供給連通孔
26 811a~813d及……」(參乙證11圖28及說明書第[0259]段，
27 本院卷五第140頁)。其中「晶圓容器10」可對應系爭專利
28 請求項15要件編號15A「一種基板容器」；「上部板900、
29 第1下部板810、第1噴射部內壁面340、第2噴射部內壁面3
30 50、第1噴射部外壁面361、第2噴射部外壁面362」之元件
31 組合整體可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一殼

體」；「收納室200」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一內部空間」；「前方開口部251」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一前開口」；「第1噴射部外壁面361」之右側面可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第一側壁」；「第2噴射部外壁面362」之左側面可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第二側壁」；「第1噴射部內壁面340、第2噴射部內壁面350、第1噴射部外壁面361後側面、第2噴射部外壁面362後側面」之元件組合整體可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一後壁」；「第1下部板810」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一底壁」；「第1下部板810的前側邊緣」，夾在第1、2噴射部外壁面361右側面與362左側面中間處可對應系爭專利請求項15要件編號15A「該底壁包含沿該殼體之該前開口在該第一側壁與該第二側壁之間延伸之一前邊緣」；「供給連通孔811a~813d」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「複數個入口清洗埠」，故乙證11已揭露系爭專利請求項15要件編號15A全部技術特徵。

2. 乙證11已揭露系爭專利請求項15要件編號15B：

乙證11說明書揭露「如圖27所示，藉由結合同形的第1下部板至第3下部板810、820、830而構成下部板800……第1下部板810的下部結合第2下部板820，於第2下部板820的下部結合第3下部板830……連接構件850，設置至下部板800的下部」（參乙證11說明書第[0059]、[0254]至[0255]段，本院卷五第103、139頁）；乙證11說明書揭露「第1-1供給連通孔至第3-1供給連通孔811a、812a、813a及第1-2供給連通孔至第3-2供給連通孔811b、812b、813b以與配置至第1下部板810的上表面的第1供給部510對應的方式形成至第1下部板810的後方左側」（參乙證11說明書第[0260]段，本院卷五第140頁）；乙證11說明書揭露「於連接構件850形成第1主流入孔至第3-2主流入孔851a~853b……」（參乙證11說明書第[0305]段，本院卷五第148頁）；乙證1

1說明書揭露「第1-1供給流路至第3-2供給流路821a~823b
的一端分別與第1下部板810的第1-1供給連通孔至第3-2供
給連通孔811a~813b連通，另一端分別與第3下部板830的
第1-1流入孔至第3-2流入孔831a~833b連通」（參乙證11說
明書第[0273]段，本院卷五第142頁）；乙證11說明書揭露
「第1-3供給流路至第3-4供給流路821c~823d的一端分別
與第1下部板810的第1-3供給連通孔至第3-4供給連通孔81
1c~813d連通，另一端分別與第3下部板830的第1-3流入孔
至第3-4流入孔831c~833d連通」（參乙證11說明書第[027
5]段，本院卷五第142、143頁）。其中「第2下部板820、
第3下部板830、連接構件850」之元件組合整體可對應系
爭專利請求項15要件編號15B「一歧管基底」；「第2下部
板820、第3下部板830、連接構件850均位於第1下部板810
外部」可對應系爭專利請求項15要件編號15B「其設置於
該殼體之外部」；「第2下部板820、第3下部板830、連接
構件850經由供給連通孔811a~813d附接於第1下部板810」
可對應系爭專利請求項15要件編號15B「並附接於該底壁
上之該複數個入口清洗埠」；「主流入孔851a~853b」可
對應系爭專利請求項15要件編號15B「複數個入口埠」；
「主流入孔851~a853b經組態以接收清洗氣體流」可對應
系爭專利請求項15要件編號15B「其中該歧管基底具有經
組態以接收一清洗氣體流之複數個入口埠」；「供給流路
821a~823b及821c~823d」可對應系爭專利請求項15要件編
號15B「一流動路徑」；「供給流路821a~823b及821c~823
d連接至主流入孔851a~853b」可對應系爭專利請求項15要
件編號15B「且該歧管基底包含連接至該複數個入口埠之
一流動路徑」，故乙證11已揭露系爭專利請求項15要件編
號15B全部技術特徵。

3. 乙證11未揭露系爭專利請求項15要件編號15C、15D：

乙證11說明書揭露「第1-3供給流路至第3-4供給流路821c
~823d的一端分別與第1下部板810的第1-3供給連通孔至第

3-4供給連通孔811c~813d連通，另一端分別與第3下部板830的第1-3流入孔至第3-4流入孔831c~833d連通」(參乙證11說明書第[0275]段，本院卷五第142、143頁)；「第1供給部510具備分別與第1-1供給孔至第3-2供給孔371a~373b連通的第1-1供給空間至第3-2供給空間531a~533b、及分別與第1-1供給空間至第3-2供給空間531a~533b連通的第1-1垂直供給流路至第3-2垂直供給流路541a~543b」(參乙證11說明書第[0169]段，本院卷五第124頁)以及「第2供給部520具備分別與第1-3供給孔至第3-4供給孔371c~373d連通的第1-3供給空間至第3-4供給空間531c~533d及分別與第1-3供給空間至第3-4供給空間531c~533d連通的第1-3垂直供給流路至第3-4垂直供給流路541c~543d」(參乙證11說明書第[0178]段，本院卷五第126頁)。其中，乙證11並未揭露該供給流路將清洗氣體先匯集一處後再經劃分進入晶圓收納室；又「第1供給部510」及「第2供給部520」雖均為管狀(參圖式19、20)，但其功能在於向第1至3噴射部310、320、330供給氣體，再藉由310、320、330表面的噴射孔390向收納空間200噴射擴散氣體，「第1供給部510」及「第2供給部520」本身並不具備直接向收納室200擴散氣體之功能，故乙證11未揭露系爭專利請求項15要件編號15C、15D「管狀擴散器」、「該歧管基底之該流動路徑將來自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分」之技術特徵。

(二)系爭專利請求項16、17係請求項15之附屬項，包含請求項15全部技術特徵，如前所述，乙證11不足以證明請求項15不具新穎性，自不足以證明請求項16、17不具新穎性。

□、乙證2足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

(一)乙證2與系爭專利請求項15之要件逐項比對分析已如前述，乙證2與系爭專利請求項15之主要差異技術特徵在於乙證2並未揭露系爭專利15要件編號15C、15D「管狀擴散器」及「將來自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接

著劃分」。經查，系爭專利請求項15所界定之核心技術內容在於一設置於殼體外部的「歧管基底」，該歧管基底具備「複數個入口埠」，其內部的流動路徑會將來自這些複數個入口埠的清洗氣體流先進行「組合」，接著再行「劃分」，最後經由複數個入口清洗埠將氣體供應至複數個管狀擴散器。此一「多進氣源先組合、後分流」的流體控制邏輯與系爭專利說明書第[0038]段圖3B(或圖5)實施例所揭露者完全相符。又系爭專利圖3C實施例的核心技術內容在於具備至少兩個獨立的入口埠(305A及305B)，且每個入口埠各自連接至分開的供應管線(360及370)以形成獨立的分配網路，用以分別供應給不同的氣體分配裝置(參系爭專利說明書第[0040]段，本院卷一第89、90頁)。而乙證2揭露晶圓儲存容器的底部設有獨立的第一氣孔(610)與第二氣孔(620)作為氣體供應之進氣口，當氣體由第一氣孔(610)進入獨立的第一通路(510)後，會分流(劃分)為第一分支通路(512)與第二分支通路(513)，藉此分別將氣體供應至第一氣體腔室(200a)與第三氣體腔室(200c)；同理，由第二氣孔(620)進入獨立的第二通路(520)後，亦會分流為第三分支通路(522)與第四分支通路(523)，分別供應至第二氣體腔室(200b)與第四氣體腔室(200d)。乙證2中具有孔洞的分隔壁配合氣體腔室的結構，其作用實質上即完全等同於系爭專利圖3C揭露者，因此乙證2所揭露之技術核心內容與系爭專利圖3C中「多個獨立進氣口各自連接獨立管線，且每個管線又再次分岔劃分以供應不同氣體分配裝置」的核心管線架構係屬完全相同。

(二)系爭專利請求項15所界定之技術內容實質上即為系爭專利說明書圖3B(或圖5)之實施例、乙證2所揭露之技術內容實質上與系爭專利圖3C實施例相同之理由，業如前述。由於系爭專利說明書並未明確揭露圖3B、3C之實施例在設計上對於清洗或維持晶圓表面潔淨度而言究竟有何不可預期之

01 功效，且系爭專利說明書自揭「……應瞭解，儘管圖3A至
02 圖3C展示供應管線360（或370）在供應分開之氣體分配裝
03 置之前劃分，但供應管線可經分成任何數目個不同流動路
04 徑，其等可用於分開地向氣體分配裝置及/或氣體分配表
05 面之任何者供應清洗氣體，只要預定量之清洗氣體流體可
06 經設置成劃分及/或分配至各自氣體分配裝置……」（參系
07 爭專利說明書第[0042]段，本院卷一第91、93頁），可證
08 系爭專利圖3B（與系爭專利請求項15所界定之技術內容相
09 符）、圖3C（與乙證2已揭露之技術內容相符）之實施例均係
10 基於管線分流與進氣配置靈活性之「相同設計理念」所延
11 伸之變體，且原告亦自承「3A、3B、3C都是揭露基板容器
12 的示意管線圖，所以管線當然是在基板內」（參本院卷七
13 第51頁），故對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者
14 而言，參酌乙證2之教示並利用申請時之通常知識，僅需
15 對流體通路配置進行簡單地修飾，自能達成與系爭專利請
16 求項15要件編號15D「將來自該複數個入口埠之該清洗氣
17 體流組合且接著劃分」相同之氣體分配架構。此種基於相
18 同設計理念之簡單變更，實屬顯而易知且能被輕易完成
19 者。

20 (三)又系爭專利說明書中僅強調清洗流體分配系統整體在防止
21 外部氣體進入及促進氣體排出等配置效果，並未針對擴散
22 器呈現「管狀」這一特定形狀說明任何優於其他構造之功
23 效，況乙證2揭露「……不同於氣體以管線形式排出的先
24 前技術之晶圓儲存容器，氣體及晶圓之煙氣並非集中地僅
25 經由某一個區域排出，因此氣體及煙氣可有效地排出」
26 （參乙證2說明書第[0243]段，本院卷二第499頁），表示
27 「管線」形狀的擴散器結構早於乙證2申請日（自亦早於系
28 爭專利申請日）之前便已向公眾揭露，故對所屬技術領域
29 具通常知識者而言，將乙證2所揭露之技術內容簡單地進
30 行修飾即能輕易完成系爭專利請求項15要件編號15C、15D
31 與乙證2之差異技術特徵「管狀擴散器」，故「管狀擴散

器」僅為乙證2之技術內容的簡單變更。綜上，乙證2即足以證明系爭專利請求項15不具進步性。

(四)如前所述，系爭專利請求項16係請求項15之附屬項，包含請求項15全部技術特徵，請求項15不具進步性。乙證2說明書揭露「第二下部板500位在第一下部板400與第三下部板600之間……第二下部板500及第三下部板600耦接至第一下部板400之下側」（參乙證2說明書第[0184]、[0223]段，圖2，本院卷二第130、138頁）。乙證2說明書揭露「第一通路510……包含：第一吸入孔511，第一分支通路512及第二分支通路513」；「第二通路520……包含：第二吸入孔521，第三分支通路522及第四分支通路523」（參乙證2說明書第[0186]、[0194]段，圖9，本院卷二第486、488頁）。其中「第二下部板500」、「第三下部板600」設置於「第一下部板400」下側，「第一下部板400」、「第三下部板600」之間的空間(包含「第二下部板500」)可對應系爭專利請求項16「歧管基底」；「第三下部板600」可對應系爭專利請求項16「載板」，故乙證2已揭露系爭專利請求項16「該歧管基底設置於該殼體與一載板之間」之技術特徵，系爭專利請求項16亦不具進步性。

(五)系爭專利請求項17係請求項15之附屬項，包含請求項15全部技術特徵，請求項15不具進步性，已如前述。乙證2說明書揭露「穿透第一下部板400之上部表面及下部表面的第一連通孔450a至第六連通孔450f分別形成在下部板400……第一連通孔450a至第四連通孔450d發揮將……氣體分別引入第一氣體腔室200a至第四氣體腔室200d中的作用」（參乙證2說明書第[0175]、[0177]段，圖8，本院卷二第484頁）。其中「氣體腔室200e、200f」以及「分隔壁150e、150f」靠近第六外壁210f可對應系爭專利請求項17「該複數個管狀擴散器之一者經設置為較靠近該殼體之該後壁」，故乙證2已揭露系爭專利請求項17附加之技術特徵，系爭專利請求項17亦不具進步性。

01 (六)如前述，系爭專利請求項18係請求項15之附屬項，包含請
02 求項15全部技術特徵，請求項15不具進步性。乙證2揭露
03 「第一分隔壁150a至第六分隔壁150f發揮將儲存腔室100
04 及第一氣體腔室200a至第六氣體腔室200f劃分成分離獨立
05 空間的作用，並且同時，經由在第一分隔壁150a至第六分
06 隔壁150f形成之孔151來發揮連通在儲存腔室100及第一氣
07 體腔室200a至第六氣體腔室200f內部流動之氣體的作用」
08 (參乙證2說明書第[0150]段，本院卷二第479頁)。其中
09 「第一分隔壁150a至第六分隔壁150f形成之孔151」可對
10 應系爭專利請求項18「該複數個管狀擴散器包括具有多孔
11 材料之一氣體分配表面」，故乙證2已揭露系爭專利請求
12 項18附加之技術特徵，系爭專利請求項18亦不具進步性。

13 (七)原告雖主張：被告稱系爭專利說明書對於「管狀擴散器」
14 未明確教示為單一構件、未明確排除複數元件組合或接
15 合、未限制為圓管，扁管亦為管狀等語，然乙證2明白表
16 示「不同於氣體以管線形式排出」是乙證2不要實施之技
17 術手段，故被告不能提出與乙證2教示相反之答辯；又乙
18 證2揭露的是一種Panel Type的前開式晶圓容器（FOU
19 P），與請求項15採用之管狀擴散器晶圓容器係不同發展
20 之技術，系爭專利圖3A、3B、3C所示意的組合且接著劃分
21 的流動路徑，若是設在歧管基底內直接往上與管狀擴散器
22 做連接，效率應是最佳云云（參本院卷七第41、49、51
23 頁）。經查，乙證2說明書第【0243】及【0245】段係在強
24 調其透過分隔壁之複數孔洞達成「區域排出」之功效，旨
25 在說明與先前技術僅能集中於單一管路開口排放之差異，
26 並非教示排除管狀擴散器，自不構成反向教示。又系爭專
27 利說明書並未對面板狀與管狀擴散器在功能或技術軌跡上
28 做出任何區分或對立性描述，顯見兩者在氣體分配之技術
29 手段並無不合之處。系爭專利說明書雖於圖3A、3B、3C展
30 示不同之管線組合與劃分實施例，但第【0042】段已載明
31 供應管線可根據需求分成任何數目之流動路徑，各實施例

之選用實係取決於基板容器應用或對接配置之性質，說明書並未提供任何效能對比數據，亦未明確說明圖3A、3B、3C之實施例對於晶圓清潔效能有何實質差異，足以證實該三種實施例僅係基於同一流體分配設計理念所延伸之變化配置，歧管基底並無原告所謂特定實施例效率最佳之教示內容，故原告前開主張顯屬無據。

□、乙證6不足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

(一)乙證6不足以證明系爭專利請求項15不具進步性：

1.乙證6已揭露系爭專利請求項15要件編號15A：

乙證6說明書揭露「提供一種基板收納容器，其能夠效率良好地將容器本體內的空氣置換成基板用保護氣體」（參乙證6說明書第[0014]段，本院卷二第699頁）；乙證6說明書揭露「容器本體1……成形為正面2呈開口的前開箱型」（參乙證6說明書第[0041]段，圖1、圖3，本院卷二第710頁）；乙證6說明書揭露「容器本體1係在其內部兩側……分別對稱地設置……左右一對支承片3……在兩側壁的內面後部分別一體形成……位置限制部4」（參乙證6說明書第[0042]段，圖3、圖4，本院卷二第711頁）；乙證6說明書揭露「容器本體1的背面壁18係……」（參乙證6說明書第[0049]段，圖10、圖11，本院卷二第713頁）；乙證6說明書揭露「在容器本體1的底板6的前後部的兩側分別貫穿而穿孔有安裝孔7」（參乙證6說明書第[0044]段，圖7、圖8，本院卷二第711頁）。其中「基板收納容器」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一種基板容器」；「容器本體1」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一殼體」；「基板收納區域5」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一內部空間」；「正面2」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一前開口」；「兩側壁」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第一側壁、一第二側壁」；「背面壁18」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一後壁」；「底板6」可對應系爭專利請求項15

要件編號15A「一底壁」；「底板6」位於正面2延伸之邊緣可對應系爭專利請求項15要件編號15A「該底壁包含沿該殼體之該前開口……延伸之一前邊緣」；「安裝孔7」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「複數個入口清洗埠」；「安裝孔7穿孔於底板6上」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「其中複數個入口清洗埠被提供於該殼體之該底壁上」，故乙證6已揭露系爭專利請求項15要件編號15A全部技術特徵。

2. 乙證6未揭露系爭專利請求項15要件編號15B：

乙證6說明書揭露「氣體置換單元40，使氣體置換單元40的殼體41之上部支承在容器本體1的內部」（參乙證6說明書第[0038]段，圖1、圖11，本院卷二第709、710頁）。雖然乙證6亦揭露供氣閥10與偏心轉接器12位於底部（參乙證6說明書第[0045]段，圖9，本院卷二第711、712頁），但其主要之分配結構「氣體置換單元40」實質上係設置於容器本體之「內部」而非系爭專利請求項15要件編號15B所揭露之「設置於該殼體之外部」，故乙證6未揭露系爭專利請求項15要件編號15B全部技術特徵。

3. 乙證6未揭露系爭專利請求項15要件編號15C：

乙證6說明書揭露「殼體41係使用預定的成形材料形成為底較淺的稍微呈彎曲之剖面為盤形，換句話說是底較淺的稍微呈彎曲之箱形」（參乙證6說明書第[0056]段，圖14、圖15，本院卷二第715頁）。其中乙證6之氣體置換單元40雖可將清洗氣體分配至內部空間中，但其結構描述為「盤形」或「箱形」，並非系爭專利請求項15要件編號15C所界定之「管狀」擴散器，故乙證6未揭露系爭專利請求項15要件編號15C全部技術特徵。

4. 乙證6未揭露系爭專利請求項15要件編號15D：

乙證6說明書揭露「一對貯留空間44的上部間47……作為流路使從供氣閥10流入的淨化氣體從貯留空間44流通至相鄰的貯留空間44，來使淨化氣體的壓力相等並且使得從貯

留空間44吹出的淨化氣體的量會均等」（參乙證6說明書第[0059]段，圖13、圖14，本院卷二第716頁）。其中乙證6之貯留空間44與上部間47之組合雖具備將氣體流組合且平衡之功能，惟其供應之對象並非「管狀擴散器」，且其整體歧管構造與系爭專利所界定之特定流動路徑劃分方式亦因前述構造差異而無法完全對應，故乙證6未揭露系爭專利請求項15要件編號15D全部技術特徵。

5. 綜上，乙證6雖揭露基板收納容器之基本殼體構造，然其揭露之氣體置換單元40之殼體41係支承在容器本體1之「內部」（參乙證6說明書第[0038]段，圖1、圖11，本院卷二第709、710頁），與系爭專利請求項15要件編號15B明確要求歧管基底設置於殼體「外部」並附接於底壁之結構特徵顯有不同，且乙證6揭露之殼體41形狀描述為「剖面為盤形」或「底較淺之稍微呈彎曲之箱形」（參乙證6說明書第[0056]段，圖14、圖15，本院卷二第715頁），亦與要件編號15C、15D所界定之「管狀」擴散器及其流動路徑需組合並劃分後供應至管狀擴散器之特定流體分配機制迥異，此等將原本配置於容器內部之盤狀或箱狀氣體置換構造，變更為設置於殼體外部之歧管基底並連接特定管狀擴散器之技術手段，涉及整體容器空間布建、氣體流體動力學設計及構造組件之實質改變，顯非屬該技術領域中具有通常知識者利用通常知識即可將乙證6之差異特徵簡單進行修飾、置換、省略或轉用之簡單變更，故乙證6無法證明系爭專利請求項15不具進步性。

(二) 系爭專利請求項16至18係請求項15之附屬項，包含請求項15全部技術特徵。乙證6無法證明系爭專利請求項15不具進步性之理由，已如前述，故乙證6自不足以證明系爭專利請求項16至18不具進步性。

□、乙證8不足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

(一) 乙證8不足以證明系爭專利請求項15不具進步性：

1. 乙證8已揭露系爭專利請求項15要件編號15A：

乙證8說明書揭露「容器主體2具有在一端部形成有容器主體開口部21且另一端部被封閉的筒狀的壁部20」，「在容器主體2內形成有基板收納空間27」（參乙證8說明書第[0029]段，本院卷四第294頁）；乙證8說明書揭露「容器主體2的壁部20具有後壁22、上壁23、下壁24、第一側壁25以及第二側壁26」（參乙證8說明書第[0036]段，本院卷四第295頁）；乙證8說明書揭露「上壁23的前端、下壁24的前端、第一側壁25的前端以及第二側壁26的前端構成開口周緣部28，該開口周緣部28形成呈大致長方形狀的容器主體開口部21」（參乙證8說明書第[0037]段，本院卷四第296頁）；乙證8說明書揭露「後部兩個部位的貫通孔是用於向容器主體2的內部供給氣體的供氣孔242」（參乙證8說明書第[0041]段，本院卷四第296頁）。其中「基板收納容器1」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一種基板容器」；「容器主體2」及「壁部20」等元件組合整體可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一殼體」；「基板收納空間27」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一內部空間」；「容器主體開口部21」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一前開口」；「第一側壁25」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第一側壁」；「第二側壁26」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第二側壁」；「後壁22」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一後壁」；「下壁24」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一底壁」；「下壁24的前端」構成開口周緣部之結構可對應系爭專利請求項15要件編號15A「該底壁包含沿該殼體之該前開口在該第一側壁與該第二側壁之間延伸之一前邊緣」；「供氣孔242」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「複數個入口清洗埠」；「供氣孔242形成於下壁24」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「其中複數個入口清洗埠被提供於該殼體之該底壁

上」，故乙證8已揭露系爭專利請求項15要件編號15A全部技術特徵。

2. 乙證8已揭露系爭專利請求項15要件編號15B：

乙證8說明書揭露「氣道210具有氣體流入部211和水準方向伸出部212」（參乙證8說明書第[0055]段，本院卷四第299頁）；乙證8說明書揭露「氣體流入部211由圓筒狀的氣體供給裝置連接部202的內部空間構成，該氣體供給裝置連接部202形成於下壁24的後端部，向下方向D22突出並形成供氣孔242。水準方向伸出部212沿著下壁24的外表面（下表面）在下壁24的外側從氣體流入部211的上端部向後方向D12延伸，由下壁24的外表面與相比下壁24向下側突出的下側流路形成部203之間的空間構成」（參乙證8說明書第[0056]段，本院卷四第299頁）；乙證8說明書揭露「從氣體供給裝置的供氣噴嘴向氣道210供給吹掃氣體」（參乙證8說明書第[0067]段，本院卷四第301頁），其中「下側流路形成部203」及「氣體供給裝置連接部202」設置於下壁24外側並連接供氣孔242所構成之實體結構，可對應系爭專利請求項15要件編號15B「一歧管基底，其設置於該殼體之外部並附接於該底壁上之該複數個入口清洗埠」；「氣體流入部211」可對應系爭專利請求項15要件編號15B「該歧管基底具有經組態以接收一清洗氣體流之複數個入口埠」；「水準方向伸出部212」等延伸空間可對應系爭專利請求項15要件編號15B「該歧管基底包含連接至該複數個入口埠之一流動路徑」，故乙證8已揭露系爭專利請求項15要件編號15B全部技術特徵。

3. 乙證8已揭露系爭專利請求項15要件編號15C：

乙證8說明書揭露「後壁22具有作為氣體噴出噴嘴部的突出部8。突出部8兩個成對，以肋狀向容器主體開口部21突出，且平行地從後壁22的上端部延伸至下端部。即，突出部8具有中空的柱狀」（參乙證8說明書第[0050]段，本院卷四第298頁）；乙證8說明書揭露「突出部8具有將流入

到氣道210的氣體向基板收納空間27供給的多個開口部802」（參乙證8說明書第[0054]段，本院卷四第299頁）；乙證8說明書進一步揭露「與水準方向伸出部212連接的氣體滯留室801如上所述由突出部8的後側空間構成」（參乙證8說明書第[0056]段，本院卷四第299頁）。其中成對且「具有中空的柱狀」並具備多個開口部802之「突出部8」可對應系爭專利請求項15要件編號15C「複數個管狀擴散器」；突出部8之氣體滯留室801「與水準方向伸出部212連接」且將氣體「向基板收納空間27供給」之技術手段，可對應系爭專利請求項15要件編號15C「經由該複數個入口清洗埠與該歧管基底連通，以用於將該清洗氣體流分配至該殼體之該內部空間中」，故乙證8已揭露系爭專利請求項15要件編號15C全部技術特徵。

4. 乙證8未揭露系爭專利請求項15要件編號15D：

乙證8說明書揭露「氣道的水準方向伸出部也可以具有如下結構：進行分支，沿著下壁的內表面（上表面）在下壁的內側從氣體流入部的上端部向後方向延伸，並且沿著下壁的外表面（下表面）在下壁的外側從氣體流入部的上端部向後方向延伸，而後匯合」（參乙證8說明書第[0132]段，本院卷四第311、312頁）；另乙證8說明書亦揭露「在從氣道210B的水準方向伸出部212B向上方向D21延伸的垂直方向伸出部213B的上端部與開口部802B之間形成有使來自氣道210B的吹掃氣體的流動分支而構成氣體流量均勻化部的分支路8011B」（參乙證8說明書第[0096]段，本院卷四第306頁）。其中乙證8雖揭露氣道能夠進行「分支」與「匯合」，亦揭露在噴嘴內部具有將氣體流「劃分」的設計，然乙證8說明書未揭露氣體流道位於歧管基底內，亦未揭露將來自「複數個入口埠」的清洗氣體流在歧管基底之流動路徑中先進行「組合」而後再「劃分」，並供應至複數個管狀擴散器的整體流路管理技術特徵，故

乙證8未揭露系爭專利請求項15要件編號15D全部技術特徵。

5. 綜上，乙證8雖揭露基板收納容器之基本殼體構造，然其揭露之分支路8011B或氣道210B結構係設置於噴嘴內部或下壁內外側（參乙證8說明書第[0096]、[0132]段，圖14，本院卷四第306、311、312頁），與系爭專利請求項15要件編號15B明確要求歧管基底設置於殼體「外部」並附接於底壁之結構特徵顯有不同。且乙證8揭露之技術僅涉及於噴嘴內部流量均勻化之分支設計，或氣道於下壁內外側之單純分支與匯合（參乙證8說明書第[0096]、[0132]段，本院卷四第306、311、312頁），亦與要件編號15D所界定將來自「複數個入口埠」之清洗氣體流於歧管基底之流動路徑中先進行「組合」而後再「劃分」並供應至複數個管狀擴散器之特定流路管理機制迥異。此等將原本配置於噴嘴內部或下壁之氣道構造，變更為設置於殼體外部之歧管基底並具備特定「先組合後劃分」之流路分配技術手段，涉及整體容器空間布建、氣體流體動力學設計及構造組件之實質改變，顯非屬該技術領域中具有通常知識者利用通常知識即可將乙證8之差異特徵簡單進行修飾之簡單變更。系爭專利請求項15具有進步性，而請求項16至18均係直接或間接附屬於請求項15之附屬項，包含請求項15全部技術特徵，故乙證8亦不足以證明系爭專利請求項16至18不具進步性。

□、乙證11足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

(一)如前所述，乙證11未揭露系爭專利請求項15之要件編號15C、15D，乙證11於底部連接構件設有複數個主流入孔（如851a至853b）作為獨立進氣口，當清洗氣體由單一主流入孔（如第1-1主流入孔851a）進入後，會於下部板內部之流動路徑中分流（劃分）為兩條供給流路（如821a與821c），進而分別將氣體供應至分開之噴射部（如第1-1噴射部310a與第1-3噴射部310c），由於乙證11之噴射部及其

上之噴射孔實質上即扮演了系爭專利所定義之氣體分配裝置角色，且其透過底板內部分支流道達成之「獨立進氣後再次分流供應不同單元」之空間邏輯，與系爭專利圖3C所主張之多入口獨立分流網路架構係屬一致，故兩者之進氣結構與分流原理實質相同。系爭專利請求項15所界定之技術內容實質上即為系爭專利說明書圖3B(或圖5)之實施例，乙證11所揭露之技術內容實質上與系爭專利圖3C實施例相同。由於系爭專利說明書未明確揭露圖3B、3C之實施例在設計上對於清洗或維持晶圓表面潔淨度而言究竟有何不可預期之功效，且系爭專利說明書自揭「應瞭解，儘管圖3A至圖3C展示供應管線360（或370）在供應分開之氣體分配裝置之前劃分，但供應管線可經分成任何數目個不同流動路徑，其等可用於分開地向氣體分配裝置及/或氣體分配表面之任何者供應清洗氣體，只要預定量之清洗氣體流體可經設置成劃分及/或分配至各自氣體分配裝置……」（參系爭專利說明書第[0042]段，本院卷一第91、93頁），可證系爭專利圖3B(與系爭專利請求項15所界定之技術內容相符)、圖3C(與乙證11已揭露之技術內容相符)之實施例均係基於管線分流與進氣配置靈活性之「相同設計理念」所延伸之變體，故對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，參酌乙證11之教示並利用申請時之通常知識，僅需對流體通路配置進行簡單地修飾，自能達成與系爭專利請求項15要件編號15D「將來自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接著劃分」相同之氣體分配架構，此種基於相同設計理念之簡單變更，實屬顯而易知且能被輕易完成者。

(二)又系爭專利說明書中僅強調清洗流體分配系統整體在防止外部氣體進入及促進氣體排出等配置效果，並未針對擴散器呈現「管狀」這一特定形狀說明任何優於其他構造之功效，而乙證11之第1供給部510、第2供給部520及其內部之供給空間531a-d等，依其圖式19、20所示已明確呈現長條

01 管狀之結構，且參酌乙證11圖式27及對應說明書內容，其
02 基座內部流道已揭露將來自複數個入口埠之氣體匯合組合
03 後，再行劃分並供應至各個管狀供給部之技術特徵，縱使
04 乙證11之供給部係透過噴射部間接向內部空間噴射氣體，
05 與系爭專利直接由擴散器擴散之配置略有差異，然此僅屬
06 乙證11之技術內容的簡單變更。

07 (三)綜上所述，對於所屬技術領域具通常知識者而言，依據乙
08 證11所揭露之技術內容簡單進行修飾即能輕易完成系爭專
09 利請求項15之發明，乙證11即足以證明系爭專利請求項15
10 不具進步性。

11 (四)系爭專利請求項16係請求項15之附屬項，包含請求項15全
12 部技術特徵，請求項15不具進步性，業如前述。乙證11說
13 明書揭露「於第1下部板810的下部結合第2下部板820，於
14 第2下部板820的下部結合第3下部板830」（參乙證11說明
15 書第[0255]段，本院卷五第139頁）；乙證11說明書揭露
16 「第2下部板820……貫通第2下部板820的上表面與下表面
17 的方式分別形成第1-1供給流路至第3-4供給流路821a~823
18 d」（參乙證11說明書第[0271]段，本院卷五第142頁）。
19 其中「第1下部板810」構成收納室底面，可對應系爭專利
20 請求項16「該殼體」之一部分；「第1下部板810」與「第
21 3下部板830」之間的空間(包含「第2下部板820」)具有複
22 數供給流路可對應系爭專利請求項16「歧管基底」；「第
23 3下部板830」設置於底部並連接外部供給線路，可對應系
24 爭專利請求項16「載板」，故乙證11已揭露系爭專利請求
25 項16「該歧管基底設置於該殼體與一載板之間」之技術特
26 徵，系爭專利請求項16亦不具進步性。

27 (五)如前述，系爭專利請求項17係請求項15之附屬項，包含請
28 求項15全部技術特徵，請求項15不具進步性。乙證11說明
29 書揭露「第1-2噴射部，向第1吹掃區域的後方左側噴射吹
30 掃氣體……第1-4噴射部，向第1吹掃區域的後方右側噴射
31 吹掃氣體」（參乙證11說明書第[0051]段，本院卷五第1

00頁)；乙證11說明書揭露「第1-2噴射部至第3-2噴射部310b、320b、330b與第1-4噴射部至第3-4噴射部310d、320d、330d……發揮向收納室200的後方排放……功能」(參乙證11說明書第[0149]段，圖2、圖11，本院卷五第120頁)。其中「第1-2噴射部、第1-4噴射部」等位於後方之噴射構造，可對應系爭專利請求項17「該複數個……擴散器之一者經設置為較靠近該殼體之該後壁」，故乙證11已揭露系爭專利請求項17附加之技術特徵，系爭專利請求項17亦不具進步性。

(六)系爭專利請求項18係請求項15之附屬項，包含請求項15全部技術特徵，請求項15不具進步性，已如前述。乙證11說明書揭露「於第1噴射部內壁面340及第2噴射部內壁面350形成多個噴射孔390」(參乙證11說明書第[0105]段，本院卷五第112頁)。乙證11說明書揭露「於噴射孔390的數量變多而密集地配置多個噴射孔390的情形時，可達成如自作為收納室200的外圍面的第1噴射部內壁面340及第2噴射部內壁面350整體噴射吹掃氣體的一種面噴射效果」(參乙證11說明書第[0118]段，本院卷五第115頁)。其中「噴射部內壁面340、350」及其「噴射孔390」所構成之面噴射構造可對應系爭專利請求項18「該複數個……擴散器包括具有多孔材料之一氣體分配表面」，故乙證11已揭露系爭專利請求項18附加之技術特徵，系爭專利請求項18亦不具進步性。

□、乙證2、6之組合、乙證2、8之組合、乙證2、9之組合、乙證5、2之組合、乙證5、6之組合、乙證5、8之組合、乙證5、9之組合、乙證11、5之組合、乙證11、6之組合、乙證11、8之組合、乙證11、9之組合，足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

(一)乙證2、6之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

乙證2、6與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，業如前述。又如前所述，乙證2足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性。乙證2揭露由「第一下部板400」、「第二下部板500」及「第三下部板600」構成之具有通路之板狀組件，以及由複數氣體腔室與設有孔151之分隔壁構成之氣體分配構造，乙證6揭露將氣體置換單元之殼體支承於容器本體之背面壁18，且在殼體與外罩間設有透氣性之過濾構件56以吹出淨化氣體，乙證2、6均屬前開式晶圓儲存盒之技術領域，且均為解決「如何效率良好且均勻地將容器內的空氣置換成保護氣體，以便有效地防止晶圓受污染」問題所設計，具所欲解決問題之共通性，該領域具通常知識者當有充足動機將乙證2、6所揭露之技術內容組合以完成系爭專利請求項15至18之發明，故乙證2、6之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性。

(二)乙證2、8之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

乙證2、8與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，業如前述。又如前所述，乙證2足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性，乙證2揭露由第一至第三下部板（400、500、600）構成之歧管與載板構造，以及藉由分隔壁（150a-150f）上之孔（151）達成之氣體連通與分配構造，乙證8揭露於容器後壁（22）設有具多個開口部（802）之氣體噴出噴嘴部（8），並具備氣體滯留室（801）或分支路（8011B）等流量均勻化部，以使氣體以均勻流量噴出，乙證2、8均屬前開式晶圓儲存盒之技術領域，且均為解決「如何可靠且均勻地在基板收納空間內進行氣體置換，以有效防止基板受污染」問題所設計，具所欲解決問題之共通性，該領域具通常知識者當有充足動機將乙證2、8所揭露之技術內容組合以完成系爭專利請求項15至18之發明，故乙證2、8之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性。

01 (三)乙證2、9之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步
02 性：

03 乙證2與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，已如前
04 述。如前述，乙證2足以證明系爭專利請求項15至18不具
05 進步性。乙證2揭露一種晶圓儲存容器，其包含儲存腔室
06 及與其連通之複數個氣體腔室，透過側表面分隔壁上之複
07 數個孔洞，向儲存於內部的複數個晶圓均勻供應或排出氣
08 體（如氮氣）。乙證9揭露一種用於大量沈積材料之微特
09 徵工件處理裝置，其工件固持器之柱子承載有縱向延伸之
10 氣體輸送導線管，該導線管具有複數個出口，可將處理氣
11 體或淨化氣體橫向引導至每對鄰近工件間之處理空間，以
12 增強沈積均勻度及淨化效率。乙證2、9均屬「半導體晶圓
13 或微特徵工件之處置裝置及環境控制」之技術領域，且具
14 「利用鄰近於工件側邊之導流構造（如導線管或氣室）與
15 出口孔洞，在批次排列之工件間進行氣流場分配與局部環
16 境淨化」之功能。由於兩者具功能或作用之共通性，該領
17 域具通常知識者為當有充足動機參考乙證9利用設置於支
18 撐柱上之導線管與多點出口來精準引導氣流之教示，將其
19 與乙證2之空間配置技術內容組合，以完成系爭專利請求
20 項15至18之發明，故乙證2、9之組合足以證明系爭專利請
21 求項15至18不具進步性。

22 (四)乙證5、2之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步
23 性

24 1. 乙證5已揭露系爭專利請求項15要件編號15A：

25 乙證5說明書揭露「一用於儲存複數個基板32之基板容器3
26 0。基板容器30包含二個相對之側部34、一頂部36、一底
27 部38以及一背部42」（參乙證5說明書第[0019]段，圖1，
28 本院卷二第636、637頁）；乙證5說明書揭露「基板容器3
29 0之一前部44包含一門框架46，門框架46界定一開口(open
30 ing) 48。一門52適以密封地覆蓋開口48」（參乙證5說明
31 書第[0019]段，本院卷二第637頁）；乙證5說明書揭露

「基板容器30之特徵亦在於容納一微環境64」（參乙證5說明書第[0019]段，本院卷二第637頁）；乙證5說明書揭露「底部38界定一內表面或一底板40」（參乙證5說明書第[0019]段，本院卷二第637頁）；乙證5說明書揭露「一入口接頭400……包含一基座部404，基座部404界定一穿過基座部404之軸向開孔408」（參乙證5說明書第[0068]段，圖16A、16B、19，本院卷二第651頁）。其中「基板容器30」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一種基板容器」；「側部34、頂部36、底部38及背部42」之組合整體可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一殼體」；「微環境64」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一內部空間」；「開口48」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一前開口」；「二個相對之側部34」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一第一側壁」及「一第二側壁」；「背部42」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一後壁」；「底部38」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「一底壁」；「底部38」位於前部44處之邊緣可對應系爭專利請求項15要件編號15A「該底壁包含沿該殼體之該前開口在該第一側壁與該第二側壁之間延伸之一前邊緣」；「入口接頭400之軸向開孔408」可對應系爭專利請求項15要件編號15A「複數個入口清洗埠」，且其提供於底部38（底壁）上，故乙證5已揭露系爭專利請求項15要件編號15A全部技術特徵。

2. 乙證5已揭露系爭專利請求項15要件編號15B：

乙證5說明書揭露「一種用於一多孔塔擴散器總成之入口接頭……吹洗模組502可被配置成安裝於基板容器30之底部38中」（參乙證5說明書第[0017]、[0080]段，圖19，本院卷二第633、655頁）；乙證5說明書揭露「入口接頭400……包含一基座部404，基座部404界定一穿過基座部404之軸向開孔408……一管嘴406自基座部404之一第一面410延伸……界定穿過其中之一中心通道412」（參乙證5說

明書第[0068]段，圖16B，本院卷二第651頁）。其中「入口接頭400」或「吹洗模組502」安裝於底壁，且其結構可對應系爭專利請求項15要件編號15B「一歧管基底，其設置於該殼體之外部並附接於該底壁上之該複數個入口清洗埠」；「軸向開孔408」或「入口埠437」可對應系爭專利請求項15要件編號15B「該歧管基底具有經組態以接收一清洗氣體流之複數個入口埠」；「中心通道412」或「入口接頭內之通道」可對應系爭專利請求項15要件編號15B「該歧管基底包含連接至該複數個入口埠之一流動路徑」，故乙證5已揭露系爭專利請求項15要件編號15B全部技術特徵。

3. 乙證5已揭露系爭專利請求項15要件編號15C：

乙證5說明書揭露「多孔媒介擴散器402可操作地耦合管嘴406。多孔媒介擴散器402可包含一界定一開放多孔結構424之壁422……多孔媒介擴散器402可界定一擴散器通道426」（參乙證5說明書第[0069]、[0070]段，圖16B、16C，本院卷二第651頁）；乙證5說明書揭露「多孔塔，被配置成一燒結聚合物管狀部」（參乙證5申請專利範圍第1項，本院卷二第671頁）。其中「多孔媒介擴散器402」或「擴散器總成70」被描述為具有「管狀部」之「多孔塔」，且經由入口接頭與底壁清洗埠連通，將氣體分配至容器內部空間。此結構可對應系爭專利請求項15要件編號15C「複數個管狀擴散器，其經由該複數個入口清洗埠與該歧管基底連通，以用於將該清洗氣體流分配至該殼體之該內部空間中」，故乙證5已揭露系爭專利請求項15要件編號15C全部技術特徵。

4. 乙證5未揭露系爭專利請求項15要件編號15D：

乙證5說明書揭露「多擴散器總成380包含三個單獨之擴散器本體382a、382b、及382c……分別可操作地耦合至一入口管386a、386b、及386c」（參乙證5說明書第[0060]段，圖15A、15B，本院卷二第649頁）；乙證5說明書亦揭

01 露「可被調節以增大或減小穿過各自之擴散器本體382a、
02 382b、及382c之相對流動速率」（參乙證5說明書第[006
03 4]段，本院卷二第650頁）。其中乙證5雖揭露了多個擴散
04 器分別由個別的入口管（386a-c）供應氣體，且可透過流
05 量閥調節流速，但其流路設計為個別獨立之管路。乙證5
06 說明書並未揭露「將來自該複數個入口埠之清洗氣體流組
07 合且接著劃分」之單一歧管路徑管理技術特徵，亦即其並
08 未揭露將複數來源氣體先進行「組合」後再行「劃分」供
09 應至擴散器之特定流動路徑機制。綜上，乙證5未揭露系
10 爭專利請求項15要件編號15D全部技術特徵。

- 11 5. 乙證5雖未揭露系爭專利請求項15要件編號15D「將來自該
12 複數個入口埠之清洗氣體流組合且接著劃分」技術特徵，
13 此為乙證5與爭專利請求項15之主要差異技術特徵，但乙
14 證2已揭露該主要差異特徵，已如前述，乙證5揭露一種具
15 備管狀多孔塔及對應入口接頭之擴散器總成，該多孔塔可
16 引導氣態工作流體朝向容器開口噴出，以對抗環境空氣湧
17 入並維持微環境之潔淨度，乙證2揭露由複數下部板件（4
18 00、500、600）構成之歧管流路構造，其內部設有第一及
19 第二通路用以將氣體分流供應至連通孔，乙證2說明書揭
20 露，當晶圓儲存容器10耦接至載入埠時，載入埠之氣體供
21 應噴嘴會耦接至第三下部板600之「第一氣孔610」及「第
22 二氣孔620」（對應系爭專利之複數個入口埠）並與其連
23 通。氣體經由前述複數個入口（610、620）引入第三下部
24 板600與第二下部板500所組成之空間（比對為系爭專利請
25 求項15之歧管基底），其內部之第一通路510與第二通路52
26 0，由於第二下部板500與第三下部板600是經由螺紋耦接
27 形成的整合性結構，因此來自複數個入口埠（610、620）
28 的清洗氣體流在歧管基座之整體流路系統中被共同接收與
29 處理，此一歧管結構整體管理了複數個入口的進氣，可對
30 應系爭專利請求項15要件編號15D清洗氣體流「組合」，
31 又該清洗氣體由入口埠進入後，經由歧管內之第一至第四

01 分支通路512、513、522、523將氣體流進行分流之設計，
02 此一結構可對應請求項15要件編號15D「劃分」，故乙證2
03 已揭露系爭專利請求項15要件編號15D「該歧管基底之該
04 流動路徑將來自該複數個入口埠之該清洗氣體流組合且接
05 著劃分，並經由該複數個入口清洗埠將該清洗氣體流供應
06 至該……管狀擴散器」之技術特徵。乙證5、2均屬前開式
07 晶圓儲存盒之技術領域，且均為解決「如何均勻且效率良
08 好地吹洗容器內部空間以置換空氣，並有效地防止外部雜
09 質污染基板」問題所設計，具所欲解決問題之共通性，該
10 領域具通常知識者當有充足動機將乙證5、2所揭露之技術
11 內容組合以完成系爭專利請求項15之發明，故乙證5、2之
12 組合足以證明系爭專利請求項15不具進步性。

13 6.系爭專利請求項16至18係請求項15之附屬項，包含請求項
14 15全部技術特徵，乙證2已揭露系爭專利請求項16至18之
15 附加技術特徵之理由已如前述，故乙證5、2之組合足以證
16 明系爭專利請求項16至18不具進步性。

17 (五)乙證5、6之組合不足以證明系爭專利請求項15至18不具進
18 步性：

19 乙證5、6與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，已如
20 前述。乙證5、6均未揭露系爭專利請求項15要件編號15D
21 「該歧管基底之該流動路徑將來自該複數個入口埠之該清
22 洗氣體流組合且接著劃分」之技術特徵，且該技術特徵並
23 非所屬技術領域具通常知識者可輕易完成之簡單變更，故
24 乙證5、6之組合不足以證明系爭專利請求項15至18不具進
25 步性。

26 (六)乙證5、8之組合不足以證明系爭專利請求項15至18不具進
27 步性：

28 乙證5、8與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，業如
29 前述。乙證5、8均未揭露系爭專利請求項15要件編號15D
30 「該歧管基底之該流動路徑將來自該複數個入口埠之該清
31 洗氣體流組合且接著劃分」之技術特徵，且該技術特徵並

01 非所屬技術領域具通常知識者可輕易完成之簡單變更，故
02 乙證5、8之組合不足以證明系爭專利請求項15至18不具進
03 步性。

04 (七)乙證5、9之組合，不足以證明系爭專利請求項15至18不具
05 進步性：

06 乙證5與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，已如前
07 述。乙證5、9均未揭露系爭專利請求項15要件編號15D
08 「該歧管基底之該流動路徑將來自該複數個入口埠之該清
09 洗氣體流組合且接著劃分」之技術特徵，且該技術特徵並
10 非所屬技術領域具通常知識者可輕易完成之簡單變更，況
11 乙證5揭露之技術係關於適用於在潔淨環境中「儲存或運
12 送」物體之可運送基板容器技術領域，主要在解決容器開
13 口暴露於周圍環境時，如何透過擴散器塔總成產生不均勻
14 流動分佈以對抗環境空氣湧入，進而將微環境維持在低濕
15 度之目標值之問題而乙證9則屬於「微特徵工件處理（如
16 化學氣相沉積或原子層沉積）」之製程技術領域，其目的
17 在於提供一種處理裝置與方法，透過氣體分配器將處理氣
18 體引導至工件間之處理空間，以解決大量沉積材料於工件
19 上時之均勻度與化學反應效率之問題。兩者一為針對容器
20 內部環境之「潔淨度維持與吹洗」，一為針對工件表面之
21 「化學薄膜沉積製程」，技術領域與功能作用迥異，且所
22 欲解決之課題亦完全不同，該領域具通常知識者並無充足
23 動機將其組合，故乙證5、9之組合不足以證明系爭專利請
24 求項15至18不具進步性。

25 (八)乙證11、5之組合、乙證11、6之組合、乙證11、8之組
26 合、乙證11、9之組合，足以證明系爭專利請求項15至18
27 不具進步性：

28 1.乙證11、5之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進
29 步性：

30 乙證11與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，業如前
31 述。如前述，乙證11足以證明系爭專利請求項15至18不具

進步性，乙證11揭露由第1下部板810、第2下部板820及第3下部板830構成之底面流路組件，以及於噴射部內壁面形成多個噴射孔390以達成面噴射效果之構造，乙證5揭露一種擴散器塔總成（70），包含具有多孔外套管之入口塔，且該擴散器可鄰設於容器之背部（42）並朝向開口（48）引導吹洗氣體，以對抗環境空氣之湧入，乙證11、5均屬前開式晶圓儲存盒之技術領域，且均為解決「如何有效吹洗基板容器內之微環境，以排除水分、氣態雜質或微粒，並在門開啟時防止環境空氣侵入影響晶圓良率」問題所設計，具所欲解決問題之共通性，該領域具通常知識者當有充足動機將乙證11、5所揭露之技術內容組合以完成系爭專利請求項15至18之發明，故乙證11、5之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性。

2. 乙證11、6之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

乙證11足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性、乙證11與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，均如前述。乙證11揭露由第1下部板810、第2下部板820及第3下部板830構成之底面流路組件，以及於噴射部內壁面形成多個噴射孔390以達成面噴射效果之氣體分配構造，乙證6揭露將氣體置換單元之殼體支承於容器本體之背面壁18，且在殼體與外罩間設有透氣性之過濾構件56以吹出淨化氣體，乙證11、6均屬前開式晶圓儲存盒之技術領域，且均為解決「如何效率良好且均勻地將容器內的空氣置換成保護氣體，以便防止晶圓受污染」問題所設計，具所欲解決問題之共通性，該領域具通常知識者當有充足動機將乙證11、6所揭露之技術內容組合以完成系爭專利請求項15至18之發明，故乙證11、6之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性。

3. 乙證11、8之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

乙證11足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性、乙證11與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，均如前述。乙證11揭露由第1下部板810、第2下部板820及第3下部板830構成之底面流路組件，以及於噴射部內壁面形成多個噴射孔390以達成面噴射效果之氣體分配構造，乙證8揭露於容器後壁22設有具多個開口部802之氣體噴出噴嘴部8，並具備氣體滯留室801或分支路8011B等流量均勻化部，以使氣體以均勻流量噴出，乙證11、8均屬前開式晶圓儲存盒之技術領域，且均為解決「如何可靠且均勻地在基板收納空間內進行氣體置換，以有效防止基板受污染」問題所設計，具所欲解決問題之共通性，該領域具通常知識者當有充足動機將乙證11、8所揭露之技術內容組合以完成系爭專利請求項15至18之發明，故乙證11、8之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性。

(九)乙證11、9之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性：

乙證11與系爭專利請求項15至18之逐項要件比對，業如前述。乙證11足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性，亦陳述如前。乙證11揭露一種晶圓儲存盒及其氣體分流組件，該儲存盒包含一殼體及氣體分流組件，該分流組件由集管與複數條支管組成，用以將清潔氣體供應至殼體內部的儲存空間，以移除晶圓表面的污染物、水分或氧氣。乙證9揭露一種用於微特徵工件處理裝置之工件固持器，其支撐柱內部或表面承載有縱向延伸之氣體輸送導線管，該導線管設有複數個橫向出口，能直接將處理氣體或淨化氣體引導至每對鄰近工件（晶圓）之間的處理空間，以確保氣體分佈均勻並提高淨化效率。乙證11、9均屬「半導體晶圓處置構造及其氣體流場分配控制」之技術領域，且具「利用設置於工件支撐結構旁之氣體導引管路與多點排放孔（出口），將氣體精確輸送至批次排列之晶圓間隙以管理表面微環境」功能。具功能或作用之共通性，該領域具

通常知識者當有充足動機將乙證9利用支撐柱整合導線管與側向噴嘴之技術教示，組合於乙證11之晶圓儲存環境控制構造中，以完成系爭專利請求項15至18之發明，故乙證11、9之組合足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性。

陸、綜上所述，系爭產品落入系爭專利15至17之文義範圍、請求項18之均等範圍，系爭專利說明書未違反專利法第26條第1項規定，系爭專利請求項15無不明確，且為說明書所支持，未違反專利法第26條第2項之規定，惟系爭專利請求項15至18有應撤銷之事由，則系爭產品無侵害原告系爭專利之情事。從而，原告主張依前揭規定，請求判決如前述聲明所載，並無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。且原告既不得以系爭專利遭侵害請求排除、賠償損害及銷毀系爭產品，本件即無另為中間判決之必要，爰為終局判決。

據上論結，本件原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 5 月 13 日

智慧財產第二庭

法 官 王 碧 瑩

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 115 年 5 月 13 日

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

I 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

V 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。